

tok 東京応化工業株式会社

〒211-0012

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地

<http://www.tok.co.jp>



Maximize the Value We Deliver

アニュアルレポート2015

2015年3月期

Maximize the Value We Deliver

経営理念

技術のたゆまざる研鑽、製品の高度化、社会への貢献、自由闊達

経営ビジョン

高付加価値製品による感動(満足できる性能、コスト、品質)を通じて、
世界で信頼される企業グループを目指す。

提供価値の源泉 —感動を創造する微細加工技術

東京応化は、ナノメートル*領域での微細化と応用技術の展開、
そして顧客密着戦略と新しい視点からの高付加価値技術開発により、
半導体製造をはじめとする、幅広い分野で価値を提供しています。

*1ナノメートル(1nm)=100万分の1ミリメートル。髪の毛の太さの約10万分の1

CONTENTS

東京応化の提供価値

- 02 巻頭特集
—The Value We Deliver
- 12 10年財務・非財務ハイライト
- 14 主要指標のトレンド
- 16 At a Glance
事業ポートフォリオ／製品ポートフォリオ&2015ハイライト
- 18 収益ドライバの3本柱が生み出す提供価値



成長戦略

- 19 社長メッセージ
- 27 社長・アナリスト対談
- 30 事業セグメント別概況
- 38 第2特集 —Maximize the Value We Deliver
さらなる提供価値拡大へ向けた今後の成長戦略



コーポレート・ガバナンス

- 46 社外取締役インタビュー
- 48 コーポレート・ガバナンス体制
- 56 「攻め」と「守り」の環境経営で、企業価値の向上へ
- 58 取締役、監査役および執行役員



財務情報・企業データ

- 59 経理本部長メッセージ／
財政状態および経営成績の分析
- 64 事業等のリスク
- 66 連結財務諸表
- 71 グローバルネットワーク
- 72 企業データ・株式情報



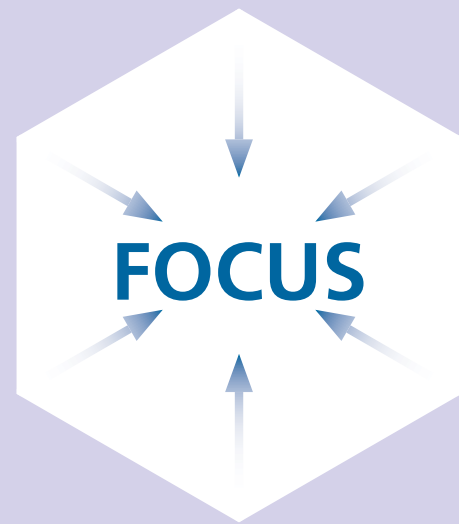
将来見通しに関する注意事項

本アニュアルレポートには、東京応化工業株式会社の事業計画、業績および経営戦略に関する将来の見通し、予想等が含まれております。そのような記載は、その時点までに入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。従って、実際の業績や経営戦略は当社の事業環境の変化により、この業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性があるため、読者の皆様におかれましてはこの業績見通し
のみに全面的に依拠されませんよう、お願いいたします。



半導体用フォトレジスト 世界No.1*

東京応化は、“世界で誰もやっていないことにチャレンジする”先取のスピリットで、“ニッチトップ”を求め続ける研究開発型企业です。

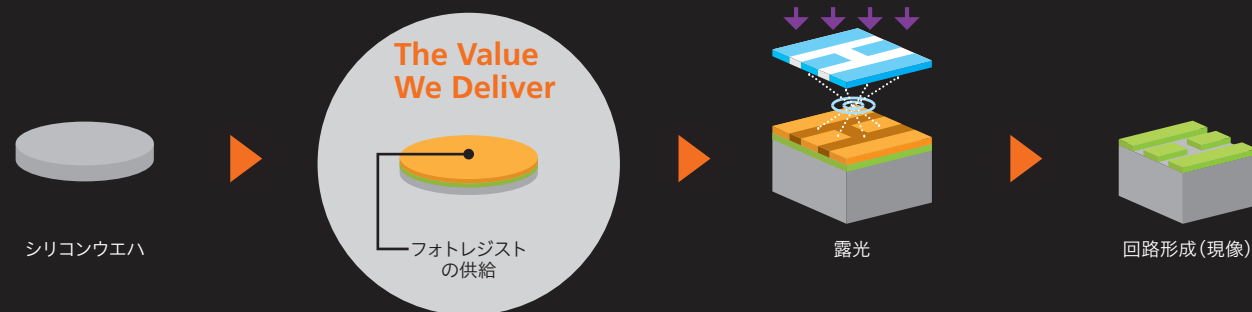


on Niche Markets



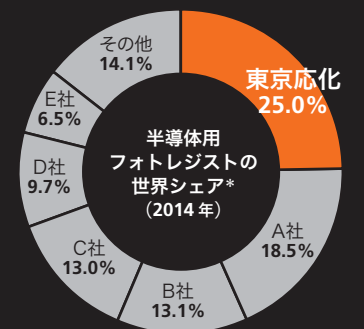
the Value We Deliver

半導体の回路形成(微細化工法)におけるフォトレジストの役割



世界の半導体の大部分は、フォトレジストを用いた微細化工法で生産されています。東京応化は、半導体用フォトレジストの世界シェアトップメーカー*です。

グローバル戦略を加速し、世界シェア拡大に邁進



*2014年のArF、KrF、g/i線用フォトレジストの合計販売数量実績ベース(富士経済「2015年 半導体材料市場の現状と将来展望」を基に当社算出)

世界最高水準の技術で、魔法のように暮らしを変えていく。

微細加工技術は、革新的な製品開発の“鍵”として、大きな役割を果たしています。そして今後も新たな価値を提供できる技術であると、私たちは確信しています。

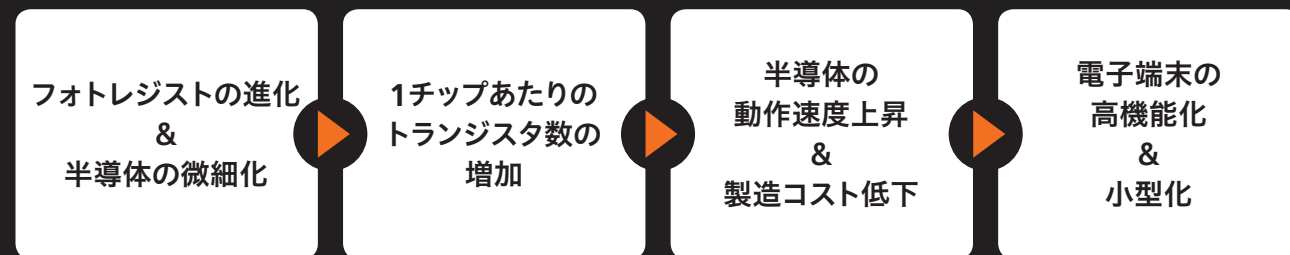


on Microprocessing Technology



Joy in Daily Life

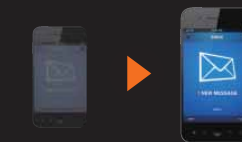
フォトリソグラフィによる半導体の微細化が、電子端末の高機能化・小型化に貢献



フォトレジストの進化と半導体の微細化は、スマートフォンやタブレット端末の進化を通じ、人々の生活をより便利で、快適にすることに貢献しています。

大手A社スマートフォンのデータ容量

7年間で約**700%拡大**



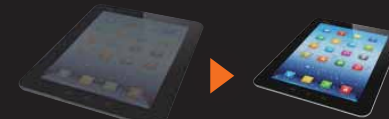
※写真はイメージです

大手A社の現行型スマートフォンは、初期型に比べて重量が4.4%減少する一方、データ容量は約700%（約8倍）拡大しています*。またタブレット端末は、初期型に比べて重量が約36%減少したほか、厚さも半分以上（約55%）スリム化されています。

これらの進化の大部分は、フォトリソグラフィの進化を含む半導体の微細化によってもたらされています。

大手A社タブレット端末の厚さ

4年間で約**55%スリム化**



※写真はイメージです

*現行型は小型機種で比較

半導体の進化を加速し、地球環境の保全に貢献する。

微細加工技術は、持続可能な社会の実現に欠かせない社会的課題の解決にも、大きく貢献しています。



on Social Issues



Environmental Benefits

フォトリソグラフィによる半導体の微細化が、消費電力およびCO₂削減に貢献



フォトレジストの進化と半導体の微細化は、半導体や電子デバイスの消費電力削減とCO₂削減を通じ、環境社会の実現に貢献しています。

LED照明の消費電力 vs 白熱電球

CO₂ 約87%削減



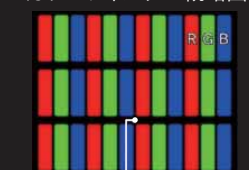
照明用として普及が進むLED（発光ダイオード）も、半導体の一種です。東京応化のフォトリソグラフィ技術は、LED分野においても用いられています。

また、液晶ディスプレイ用カラーフィルターでは、従来のクロムに替わり、環境に優しいブラックレジストが主流として用いられています。東京応化はブラックレジストのトップシェアメーカーです。

液晶ディスプレイ用ブラックレジストが

環境負荷を軽減

カラーフィルター概略図



ブラックマトリクス

顧客密着戦略で、 付加価値を最大化する。

顧客ビジネスの成功こそが、私たちの成功。

変化の激しいエレクトロニクス業界において、強固なWin-Win Relationshipを構築しています。



on our Customers' Needs



Customer Satisfaction

最適生産システムでスピーディに対応



開発成果をいち早く製品化するために、顧客環境と同等の最新の製造試作ラインを導入。
徹底した顧客密着戦略が、厚い信頼を獲得し、毎年多くのサプライヤー賞を受賞しています。

インテル社より

2014 **PQS***賞

* Preferred Quality Supplier



テキサス・インスツルメンツ社より

2014 **Supplier Excellence Award**賞



インテル社からは、コストパフォーマンス、品質、供給体制、技術力、および環境面、社会性、ガバナンスにおいて高水準である点を評価されています。

テキサス・インスツルメンツ社からは、高品質材料の提案、安定供給、サポート体制を高く評価されています。

10 The Value We Deliver

東京応化の提供価値

新たな技術開発で、提供価値を拡大し続ける。

半導体生産技術の3次元化など、テクノロジーの進化はとどまるところをありません。東京応化は未踏のフィールドへ挑戦し続けることで、持続的成長を実現していきます。

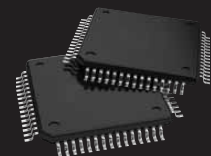


on Technological Advancement

半導体の3次元化市場の立ち上がり

半導体メーカーによる3D-NANDの量産
24層に続き

48層も開始



※写真はイメージです

半導体の3次元実装市場が、3D-NANDの量産を皮切りに本格的に拡大しつつあります。加えて微細化のパラダイムを超えた新たな3次元化技術、TSV（シリコン貫通電極）の市場が立ち上がり始めています。

微細加工技術を超えた新たな積層方式
TSV市場が前年比

13.2% 拡大へ*



当社TSV装置 ウエ/ハンドリングシステム Zero Newton®

*2015年見込み、パッケージ数ベース。
富士経済「2015年 半導体材料市場の現状と将来展望」より



We will **MAXIMIZE** our Value



“東京応化にしか生み出せない社会的価値を、今後も拡大し続けてまいります。”

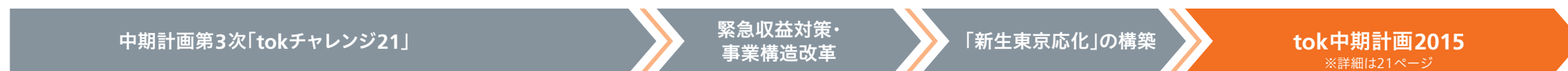
代表取締役社長

阿久津 郁夫



トップメッセージは19ページ

10年財務・非財務ハイライト



中期計画第3次「tokチャレンジ21」

戦略：
 ●微細加工技術の進化
 ●グローバル市場でのTOKブランドの確立
 ●経営体質の強化・企業風土改革

リーマンショック (2008年9月)

緊急収益対策・事業構造改革

新たな事業環境に
 適応するための
 ●コスト削減の実施
 ●低コスト体質の実現

「新生東京応化」の構築

構築の方向性：
 ●ワールドワイドでのマーケティング力の強化
 ●技術開発のさらなるスピードアップ
 ●新事業の早期確立
 ●グローバル戦略を加速し、世界シェア拡大に邁進

tok中期計画2015
※詳細は21ページ

経営ビジョン：
 「高付加価値製品による感動を通じて、世界で信頼される企業グループを目指す。」

目標：
 1. 過去最高益の更新
 2. 持続的成長の基礎となる事業基盤の強化

戦略：
 ●各地域のユーザーとの密着戦略
 ●事業ポートフォリオの変革
 ●グローバル人材の開発

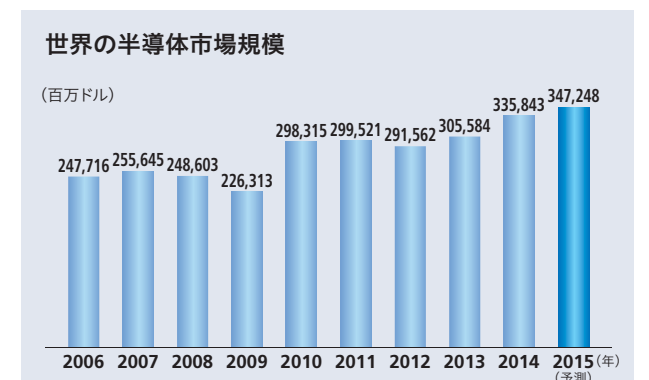
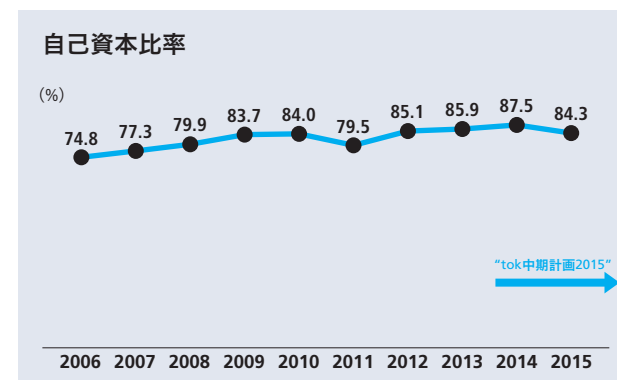
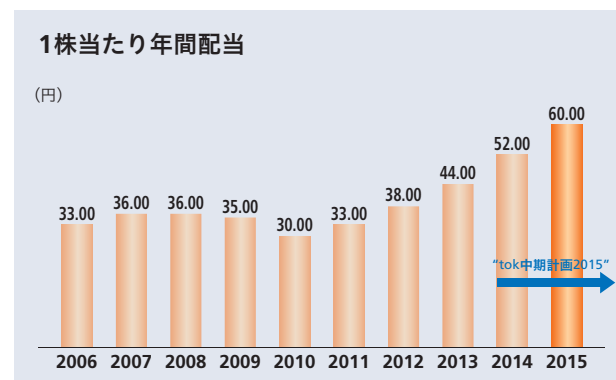
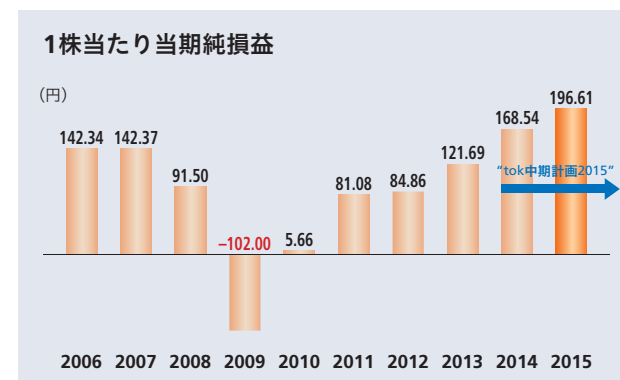
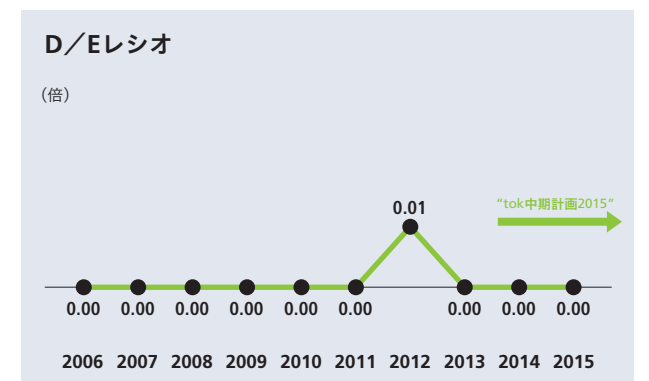
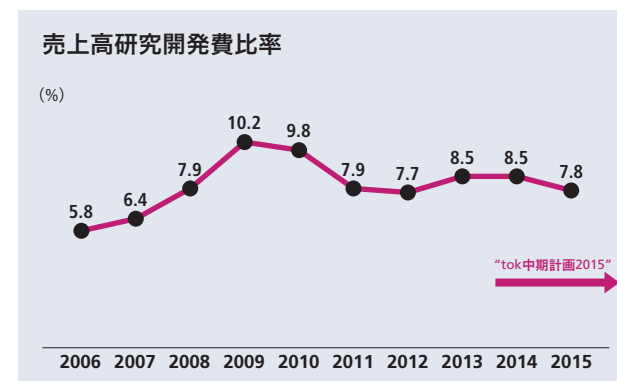
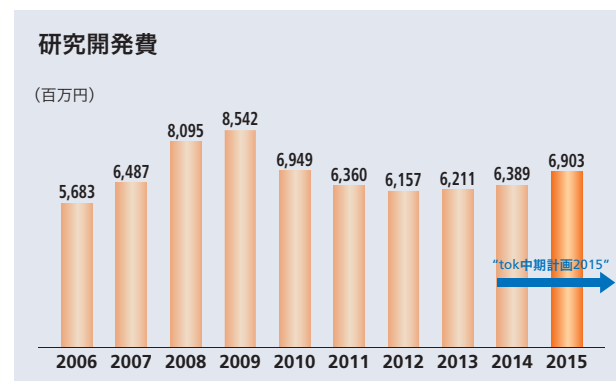
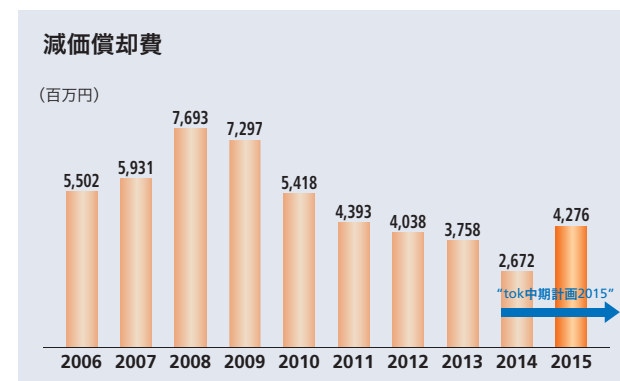
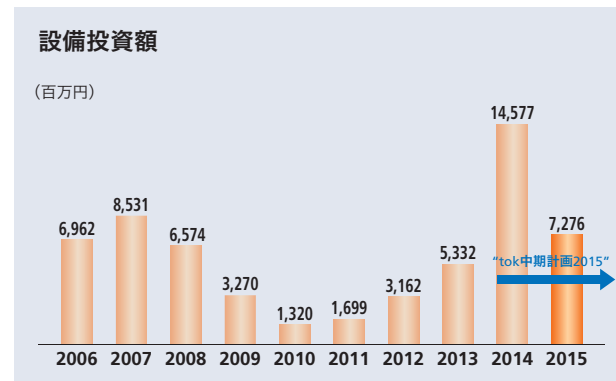
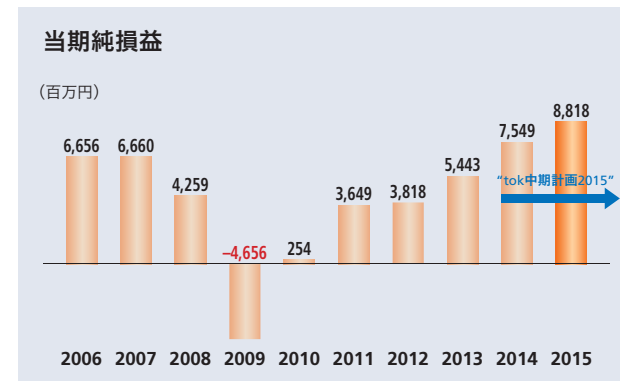
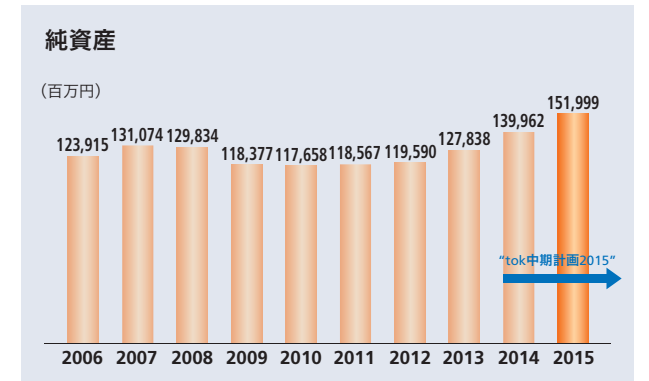
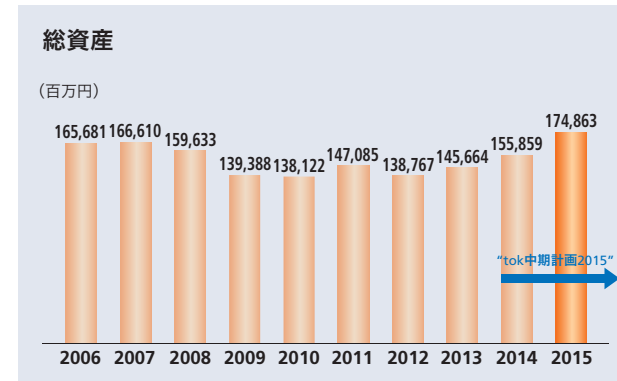
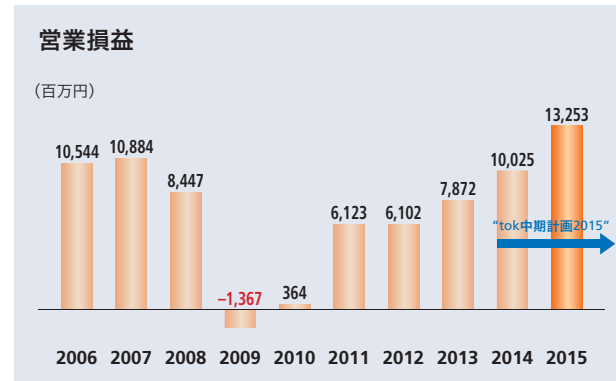
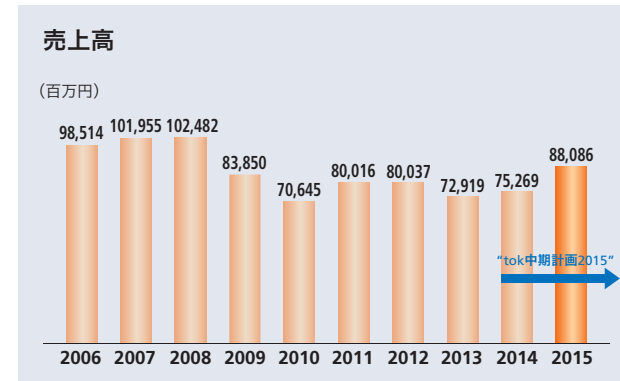
3月31日に終了した連結会計年度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	百万円 2015	千米ドル 2015
業績：											
売上高	98,514	101,955	102,482	83,850	70,645	80,016	80,037	72,919	75,269	88,086	734,055
うち材料事業	80,338	83,038	86,186	72,589	65,091	71,482	66,645	67,697	72,866	84,611	705,091
うち装置事業	18,252	18,991	16,363	11,350	5,632	8,622	13,500	5,302	2,484	3,581	29,841
営業損益	10,544	10,884	8,447	(1,367)	364	6,123	6,102	7,872	10,025	13,253	110,442
税金等調整前当期純損益	11,324	11,119	7,352	(5,325)	114	6,427	6,577	8,031	11,666	14,301	119,180
当期純損益	6,656	6,660	4,259	(4,656)	254	3,649	3,818	5,443	7,549	8,818	73,487
フリー・キャッシュ・フロー	(5,797)	(7,078)	(8,169)	8,493	6,504	12,435	(6,641)	12,363	(2,610)	3,380	28,171
設備投資額	6,962	8,531	6,574	3,270	1,320	1,699	3,162	5,332	14,577	7,276	60,633
減価償却費	5,502	5,931	7,693	7,297	5,418	4,393	4,038	3,758	2,672	4,276	35,641
研究開発費	5,683	6,487	8,095	8,542	6,949	6,360	6,157	6,211	6,389	6,903	57,525
1株当たり情報(円/米ドル)：											
1株当たり当期純損益	142.34	142.37	91.50	(102.00)	5.66	81.08	84.86	121.69	168.54	196.61	1.63
1株当たり年間配当	33.00	36.00	36.00	35.00	30.00	33.00	38.00	44.00	52.00	60.00	0.50
1株当たり純資産	2,650.51	2,750.82	2,775.38	2,591.43	2,578.30	2,597.72	2,641.28	2,796.37	3,044.24	3,285.81	27.38
年度末財政状態：											
総資産	165,681	166,610	159,633	139,338	138,122	147,085	138,767	145,664	155,859	174,863	1,457,194
固定負債合計	2,222	2,108	2,198	2,205	2,350	2,105	2,613	2,811	1,518	3,569	29,742
有利子負債	249	463	449	458	57	0	610	488	366	814	6,783
純資産	123,915	131,074	129,834	118,377	117,658	118,567	119,590	127,838	139,962	151,999	1,266,658
経営指標(%)：											
営業利益率	10.7	10.7	8.2	(1.6)	0.5	7.7	7.6	10.8	13.3	15.0	
ROE	5.6	5.3	3.3	(3.8)	0.2	3.1	3.3	4.5	5.8	6.2	
売上高研究開発費比率	5.8	6.4	7.9	10.2	9.8	7.9	7.7	8.5	8.5	7.8	
自己資本比率	74.8	77.3	79.9	83.7	84.0	79.5	85.1	85.9	87.5	84.3	
D/Eレシオ(倍)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
配当性向	23.2	25.3	39.3	—	530.0	40.7	44.8	36.2	30.9	30.5	
業界動向：											
世界の半導体市場規模(百万ドル)*1(暦年)	247,716	255,645	248,603	226,313	298,315	299,521	291,562	305,584	335,843	347,248*3	
世界のフォトレジスト販売金額(千米ドル)*2	861,773	1,119,406	1,087,982	897,827	1,129,893	1,220,078	1,279,726	1,152,306	1,290,698		
為替相場(円/米ドル)*4	117	117	99	98	93	83	82	94	103	120	
非財務データ：											
特許登録件数(国内・海外合計分を掲載)	160	260	240	259	285	247	253	271	378	293	
従業員数(人)	1,592	1,667	1,703	1,715	1,579	1,443	1,443	1,487	1,505	1,540	

*1 出典：世界半導体市場統計 *2 出典：SEMI (ArF、KrF、g/i線用フォトレジストの合計販売金額) *3 2015は予測数値 *4 各会計年度の3月末日時点

主要指標のトレンド

3月31日に終了した連結会計年度

東京応化の提供価値



事業ポートフォリオ ▶ 足元の収益を牽引する「材料事業」と、同事業との相乗効果を活かしながら新たな

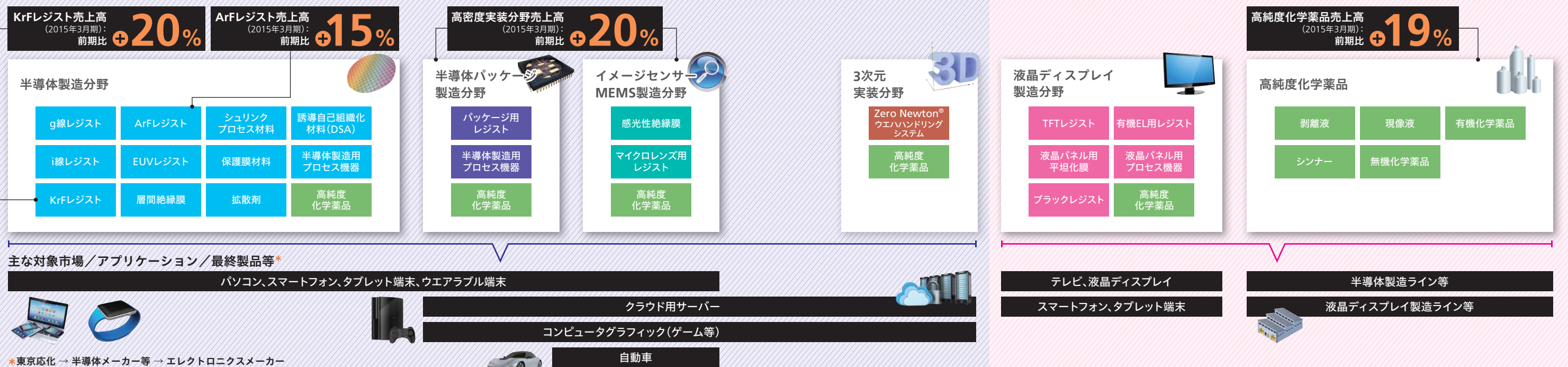
成長の柱として育成する「装置事業」を展開しています。



東京応化の提供価値

製品ポートフォリオ&2015ハイライト ▶ 2015年3月期は、材料事業を中心に以下の

製品ポートフォリオを展開し、4つの領域において大きな進捗がありました。



*東京応化 → 半導体メーカー等 → エレクトロニクスメーカー

収益ドライバーの3本柱



が生み出す提供価値

足元の収益成長を牽引するArF・KrF用フォトレジスト、高密度実装材料の特長、提供価値について解説します。

収益ドライバー 1 ArF用フォトレジスト



特長

「ArFエキシマレーザー」とは、フォトリソグラフィーの光源として用いられるレーザー光線の一つです。量産レベルで使用可能な最も短い波長(193nm)を持つことから、最も微細化が進んだ1Xnm(10nm台)以降の最先端半導体の回路生成にも用いられています。この光線に対応した特性を持つフォトレジストが、ArF用フォトレジストです。

提供価値

ArF用フォトレジストを用いて製造された最先端半導体が、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末等に用いられ、これらの高性能化、小型化、省電力化に貢献しています。

収益ドライバー 2 KrF用フォトレジスト



特長

ArFの前世代の光源であるKrFエキシマレーザー(248nm)に対応したフォトレジストであり、主に90~350nmの最先端半導体の回路生成に用いられています。

提供価値

KrF用フォトレジストを用いて製造される3D-NAND等の最先端半導体が、クラウドサーバーやゲーム機等の高性能化、省電力化に貢献します。

収益ドライバー 3 高密度実装材料



特長

- ・電子機器や電子部品の内部で半導体とその周辺部材を結合する「パッケージング」用のレジストや、マイクロメートルレベルの立体構造体を基板上に集積する“MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)”用のレジストを提供しています。
- ・パッケージング用としては高精細なバンプ形成を可能とするボジ型厚膜レジスト、MEMS用としてはレジストそのものを構造体として残す永久被膜レジストなどを提供しています。

提供価値

・厚膜レジストやMEMS用レジストを用いた電子部品が、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末の小型化、高性能化、省電力化に貢献しています。

“ エレクトロニクス業界の最先端分野において、提供価値を最大化し続けます。 ”



半導体や電子デバイスの進化は、人々の生活をより便利で快適、そして安全・安心に進展させる原動力です。東京応化はコアコンピタンスである微細加工技術を核に、エレクトロニクス業界の最先端分野において強みを発揮し続けることで、提供価値を最大化し、持続的成長に邁進します。

代表取締役社長

阿久津有夫

東京応化の提供価値

微細加工技術を通じて、便利で快適、安全・安心な日常生活に貢献

東京応化は、微細加工技術・高純度化技術を競争力の源泉とする、「研究開発型企業」です。

長年培ってきた微細加工技術により、顧客である半導体や電子デバイスメーカーの高度なニーズに応える製品をいち早く開発することで、人々の生活をより便利で快適、さらに安全・安心に進展させることに貢献しています。これが、東京応化が社会に対して提供している価値です。

当社グループのビジネスは、B to Bであり、私たちの製品が日常生活において人々の目に触れることはありません。

そこで、私たちの微細加工技術が日常生活のどのような分野に貢献しているのか、当社グループのコア製品であり、半導体製造に欠かせないフォトレジストを例にご説明いたします。

沿革：各時代におけるイノベーションの一端を担ってきた歴史

東京応化の半導体用フォトレジスト事業は、1968年にネガ型フォトレジストを、安定した品質を望む顧客の声に応える形で開発したのが始まりです。1970年代は、カラーテレビや電卓の高性能化が進み、ワープロやパソコンが登場した時代ですが、これを可能にしたのが半導体（LSI：Large Scale Integration）の進化です。当社はLSIの製造に欠かせない合成ゴム系フォトレジストを開発、さらに印刷用ポジ型フォトレジストで蓄積したノウハウを活かすことで、解

像度に優れ、集積回路のさらなる微細化に対応したポジ型フォトレジストの国産化に成功しました。これ以降も顧客の改善要望にきめ細かく応えながら、LSI製造に欠かせない主流フォトレジストとして、シェアを拡大しました。

1980年代は、LSIの微細化が進化したVLSI（Very Large Scale Integration）の時代です。VLSIはビデオデッキやビデオカメラの高機能化・小型化、CDプレーヤーや家庭用ゲーム機の普及に貢献しましたが、当社は回路の高集積化に対応した高解像度ポジ型フォトレジストを開発し、64KB DRAM製造用の標準品としての地位を確立しました。

1990年代には、VLSIがさらに進化し、ULSI（Ultra-Large Scale Integration）となりました。ULSIはゲーム機、パソコン、携帯電話の機能を高めたほか、DVDプレーヤーやハイブリッドカーの登場にも貢献しましたが、当社が開発したポジ型化学増幅型フォトレジストは、世界中のULSIメーカーに使用される標準品となりました。

また1990年代から2000年代は、液晶ディスプレイの大型化や高品質化が進んだ時代でもあります。当社は、それまで半導体分野で蓄積したノウハウと微細加工技術をベースに液晶ディスプレイ用フォトレジスト市場に本格参入し、同分野での売上を拡大しました。

このように1960年代後半からの40年以上にわたり、当社は、半導体や液晶ディスプレイの進化に欠かせないフォトレジストを開発・製造することで、今日の便利で快適なIT社会の基盤形成の一端を担いました。このことが、現在の東京応化の持続的成長の礎となっています。

るシェア*1を占めています。中でも最先端の1Xnm（10nm台）の微細化に対応する「ArF液浸*2用フォトレジスト」は技術難易度が高く、こうした高付加価値分野においても顧客からの採用を拡大し、半導体用フォトレジスト分野では世界トップのシェア*3を保有しています。

*1 出典：富士経済「2015年 半導体材料市場の現状と将来展望」
*2 露光装置（レンズ）とウエハの間に超純水を満たして露光する技術
*3 2014年のArF、KrF、g/i線用フォトレジストの合計販売数量実績ベース（上記を基に当社算出）

東京応化の強み

半導体の最先端分野でトップクラスのシェア

2000年代後半から現在にかけては、パソコンの小型化や高機能化、スマートフォンやタブレット端末の進化の時代です。これを支えているのが、微細化・高集積化を追求したDRAM・NAND型フラッシュメモリーやロジック（MPU、ASIC等）といわれる最先端の半導体デバイスです。当社グループは、半導体の先端材料であるKrF用フォトレジストに加え、最先端の半導体生産プロセスで使用されるArF用フォトレジストを開発し、世界トップクラスの20%を超え

強みは世界最高水準の微細加工技術と、きめ細かな顧客密着戦略

当社グループの成長は、私たちの製品を顧客である半導体や電子デバイスメーカーが使うことで、顧客製品の性能や品質が向上し、顧客の利益成長を実現することでもたらされます。

このためには、世界最高水準の微細加工技術を持っているだけでは不十分なのです。半導体や電子デバイスの最先端分野における開発競争では、同じ線幅のプロセスであっても、顧客によってフォトレジストに求める特性は異なります。そしてそれこそが、顧客が生み出す付加価値の源泉であることが往々にしてあります。このため、顧客の個々のニーズに対して、顧客とどれだけ緊密なやりとりを行い、どれだけきめ細かく対応できるかが、採用獲得の分岐点になります。

当社グループでは、セールスエンジニア・研究開発・製造技術・品質管理が一体となり、顧客との密接な情報のやり取りを最重視し、顧客ニーズに迅速に応えることに注力しています。

「世界最高水準の微細加工技術と高純度化技術、きめ細かな顧客密着戦略」。これが、東京応化の強みです。

今後もフィールドが広がる微細加工技術

こうした東京応化の強みを活かせるフィールドは、今後ますます広がると見込んでいます。

スマートフォンやタブレット端末の次のトレンドとして、IoT（Internet of Things）の時代が到来しつつあります。このIoT領域においてもイノベーションの原動力となるのは、半導体や電子デバイスの、さらなる高性能化と超微細化です。つまり東京応化の微細加工技術のフィールドは、日常生活におけるあらゆるモノへと広がっていきます。このチャンスを実に捉え、今後も、社会への提供価値を拡大していきます。

経営ビジョンの実践により企業価値を最大化

2014年3月期からスタートした3か年の中期計画では、2020年の「ありたい姿」として、経営ビジョン「高付加価値製品による“感動”を通じて、世界で信頼される企業グループを目指す。」の実践に取り組んでいます。

今後も東京応化は、微細加工技術をコアコンピタンスとして、顧客やエンドユーザーの皆様が感動する新しい付加価値を提供し、世界から信頼される企業グループを目指していきます。この経営ビジョンを実践することで企業価値を最大化し、持続的成長の基礎となる事業基盤の構築に努めてまいります。

tok中期計画2015の経営ビジョン、経営目標、数値目標等

経営ビジョン

- 『高付加価値製品による感動を通じて、世界で信頼される企業グループを目指す。』
- 連結営業利益：200億円（2021年3月期目標）

経営目標

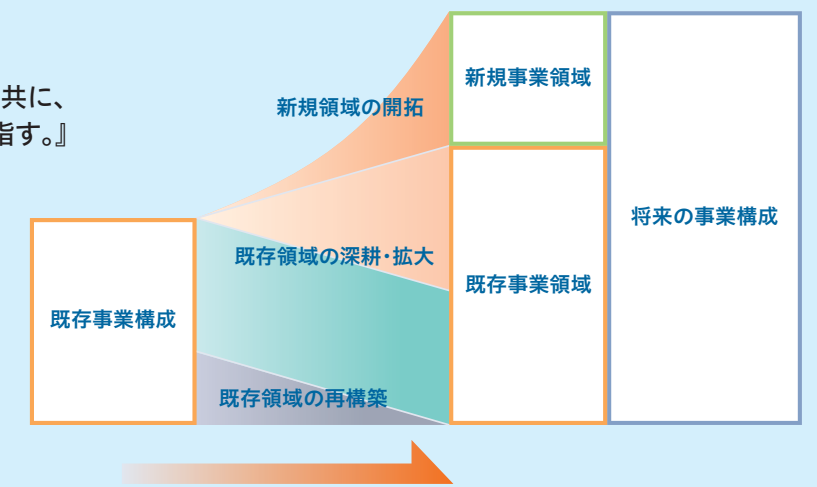
- 『既存領域の深耕・拡大を図ると共に、新規領域の早期立ち上げを目指す。』

数値目標（2016年3月期）

- 売上高：990億円
- 営業利益：150億円

tok中期計画2015の特徴

- 「過去最高益の更新」
- 「事業基盤の増強」
- 「事業領域拡張」



市場環境認識

2014年の半導体市場は前年比9.9%拡大

当社グループの売上高の約85%は、半導体関連製品によるものです(2015年3月期実績)。

2014年における世界の半導体市場は、前年比9.9%拡大し、3,358億ドルとなりました。製品別に見ると、DRAMやNAND型フラッシュメモリーといった高付加価値メモリー半導体が、スマートフォンやタブレット端末市場の拡大に加え、パソコン用OSのサポート終了に伴う買い替え特需等を背景に18.2%増加し、全体の成長を牽引しました。また、自動車向けや産業機器向け半導体市場も、それぞれ2割以上拡大しました。

(出典:世界半導体市場統計。黒下線の出典は2015年6月3日 日経産業新聞)

2017年まで平均3.2%の市場拡大が続く見通し

世界の半導体市場は、2015年も引き続き拡大し、前年比3.4%増の3,472億ドル(約41兆3,900億円)になると予想されています。パソコン関連の買い替え特需は一巡し、ゲーム機用プロセッサも低成長にとどまる見込みではあるものの、スマートフォンやタブレット端末、ウェアラブル端末向けに加え、ビッグデータ解析用データセンター向けのメモリー半導体が、今後は年率4~5%の成長を持続していくと予測されています。自動車向けLSIもこれと同等に成長すると予測されているほか、IoT市場の立ち上がりを背景に、家

電や自動車、産業用機器等に搭載するセンサー類は、年率7%程度成長していく可能性があると考えられています。

これらを総合すると、世界の半導体市場は、2014年から2017年まで、平均3.2%の安定成長が続く見通しです。

(出典:世界半導体市場統計)

アジア太平洋地域が市場成長を牽引

世界の半導体市場を地域別に見ると、当社も事業拠点の中心を置くアジア太平洋地域が、市場全体の57.8%を占めています(2014年)。中国やインド、ASEANにおけるスマートフォンやデジタル家電市場の拡大を背景に、今後も年平均5.0%程度の成長を持続し、2017年には、同地域が世界の半導体市場の60%超を占める見通しです。

(出典:世界半導体市場統計)

シリコンサイクル下における当社の「シクリカルグロス」

半導体産業は典型的な市況産業であり、この業界に関わる企業の宿命として、いわゆるシリコンサイクルの影響を受けざるを得ない側面があります。

次ページのチャートが示す通り、当社の営業利益推移とシリコンサイクルは、かなりの部分で相関しています。2015年3月期は過去最高の営業利益を達成しましたが、その大きな背景の一つとして、現在のシリコンサイクルが「上昇局面」にある点があげられます。

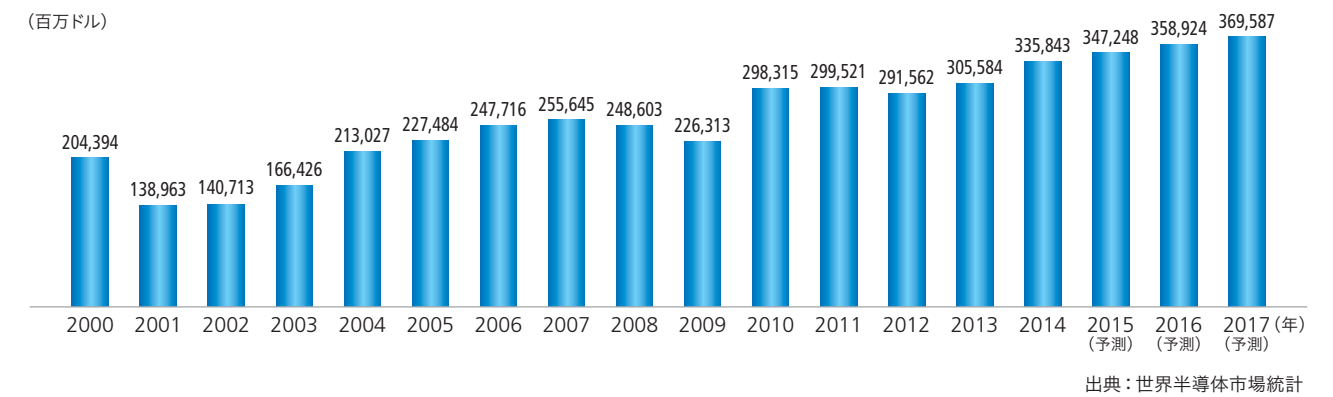
また、当社の成長軌道を見ると、景気循環に基づく変動を繰り返しながらも、長期的には右肩上がりとなる「シクリカルグロス」を持続しています。今後もシリコンサイクルの影響を受けつつも、右肩上がりの「シクリカルグロス」を持続していくことが至上命題です。

半導体業界における技術進歩のスピードは速く、機能や性能を高め続けることができなければ、その製品は価格競争に陥るか、撤退を迫られることになります。すなわち、常に最先端分野に挑戦し、高い付加価値を提供し続けなければ、成長を持続することはできません。

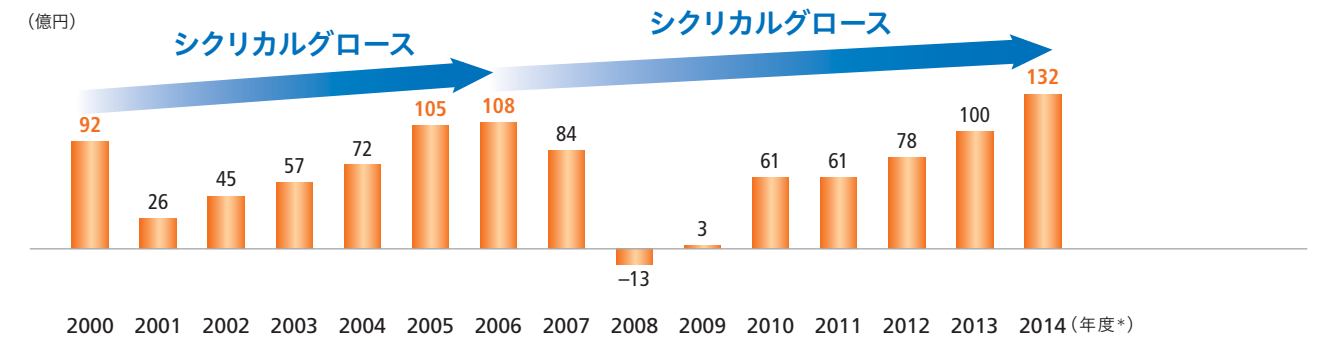
高付加価値分野での強みをさらに磨き、既存領域/新規領域を問わず、技術進化の最先端分野において提供価値の最大化を図ることが、我々の使命です。



世界の半導体市場推移



東京応化の営業損益推移



*半導体市場推移と平仄を合わせるため、当業績グラフのみ年度表記にしています。

“tok中期計画2015”2年目の進捗状況

過去最高の営業利益を達成。当期純利益も2期連続で最高益を更新

“tok中期計画2015”の2年目であった2015年3月期は、全社戦略である「各地域ユーザーに対する密着戦略」「事業ポートフォリオの変革」「グローバル人材の開発」の推進に総力を上げて取り組み、過去最高の営業利益を達成するとともに、当期純利益も2期連続で最高益を更新することができました。

これは円安の進展による利益の押し上げはあったものの、高付加価値製品であるKrF・ArF用フォトレジストや高密度実装材料の売上増加に加え、高純度化学薬品の大幅な伸長が貢献したことによるものです。

収益ドライバが多様化。課題はLCD材料、装置事業、新規事業

2015年3月期で最も特筆すべき成果は、収益ドライバが多様化した点です。

2010年3月期以降の収益回復局面においてはKrF用フォトレジストに長らく依存していましたが、これにArF用フォトレジストや高密度実装材料の売上増加、さらに高純度化学薬品の成長が加わり、安定的な収益拡大を実現できました。

一方、LCD材料、装置事業、新規事業は当初計画に対して進捗が遅れており、中期計画の完遂に向けては、これらの強化が課題であると認識しています。

“tok中期計画2015”最終年度の重点施策

収益ドライバ3本柱の成長をさらに加速

中期計画の最終年度となる2016年3月期は、まずはエレクトロニクス機能材料における収益の3本柱の拡大を加速し、引き続き過去最高益の更新を目指します。

1つ目の柱であるArF用フォトレジストを使用した微細化は、1Xnm(10nm台)世代で物理的限界に到達する見通しです。このため最終世代で採用される製品が、その後も継続的に使用される見込みであることから、1Xnm世代でのシェア獲得の成否が、レジストメーカーの今後の収益力を左右します。当社グループは、製品の特性・品質・レスポンスを重視した顧客密着戦略を展開し、大手半導体メーカーからの採用を含め、今後の収益力確保に必要な一定シェアを既に獲得しています。業績貢献は2016年3月期の下半期から始まる見込みであり、2017年3月期には通年での業績寄与を期待しています。また、需要が引き続き堅調な2Xnm(20nm台)世代の販売にも注力し、ArF用フォトレジスト市場全体での世界トップシェアを目指します。

2つ目の柱であるKrF用フォトレジストにおいては、当社は従来より28.2%(2014年、出典：富士経済『2015年半導体材料市場の現状と将来展望』)の世界トップシェアを確保しておりますが、足元では大手顧客の新たなニーズを取り込んで供給を拡大しており、トップシェアのポジ

ションをさらに強固なものにしています。2016年3月期後半から3D-NANDの量産を開始する大手顧客からも同製品向けの厚膜用KrFフォトレジストの採用を獲得しており、さらなるシェア拡大に邁進します。

3つ目の柱である高密度実装材料では、先端プロセスの実装材料であるパッケージ用材料(厚膜レジスト)やMEMS用材料の販売を拡大していきます。パッケージ用材料は、スマートフォンやタブレット、ウェアラブル端末やヘルスケア機器など、さらなる多機能化と省スペース化が求められる半導体後工程における高密度実装分野でのニーズが高まっています。当社が強みを持つ高精密向けポジ型フォトレジストの強みを活かし、拡販を図ります。MEMS用材料は、スマートフォンやIoT関連等でのセンサー需要の拡大とともに性能重視の傾向が強まっており、当社がシェアを拡大するチャンスです。顧客ニーズの深耕を図ると同時に、新たな顧客獲得に向けて、幅広い営業・開発活動を継続していきます。

高純度化学薬品

高純度化学薬品は、剥離液やシンナー、現像液など、半導体やLCDの製造に欠かせない薬品類です。2Xnm世代以降の最先端半導体の製造工程においては、フォトレジストのみならず、こうした薬品類の性能(=高純度化)が、顧

客の歩留りを左右します。高純度化技術は、当社の創業にも関わるコア技術の一つであり、微細加工技術と表裏一体をなすものとして愚直なまでに追究してまいりましたが、2015年3月期は、その価値が最先端半導体分野でも改めて認知され、大手顧客向けを中心にシェアを拡大しました。今後も顧客の製造プロセスに合わせた高品質の化学薬品を開発し、「クリーン・ソリューション(剥離液)」など、成長市場へ対応していきます。

新たな成長の柱として位置づける装置事業

半導体の微細化の追求は、いわゆる「ムーアの法則」の限界により、物理的限界が近づいていることから、1Xnm世代の次は、3次元実装分野が新たな成長領域になると見込んでいます。

3次元実装とは、半導体チップを薄片化して積み重ね、デバイスを3次元化し、高密度化・小型化を実現する技術です。当社は、この製造工程を効率的にサポートするウエハハンドリングシステム「Zero Newton®」(TSV:シリコン貫通電極装置)を展開しています。

3次元半導体市場は、クラウド用ハイエンドサーバー向けやゲーム、PC、ワークステーション用ハイエンドGPU(Graphics Processing Unit)向けを中心に、徐々に立ち上がっています。3次元実装分野は、今後の半導体業界で大きな潮流の一つであり、さらなる量産需要が立ち上がる可能性が高いため、今後の事業収益の柱として位置づけています。既存顧客のほか、新規顧客へのアプローチを強化することで、収益基盤を拡大していきます。

新規事業を確立し、2021年3月期に営業利益200億円達成を目指す

当社グループは、経営目標数値として、2021年3月期の営業利益200億円達成を目指しています。この達成へ向けたシナリオでは、「既存製品の成長+新規事業領域の確立・成長」を前提としています。売上高50億円規模の新規事業を数多く育てることで、2021年3月期においては、新規事業による売上高500億円の創出を目指していきます。

現在、当社のコアコンピタンスである微細加工技術の多角的展開、コンソーシアムや大学の研究室等の外部機関とのコラボレーションやアライアンスの活用により、事業領域の拡大を図っています。

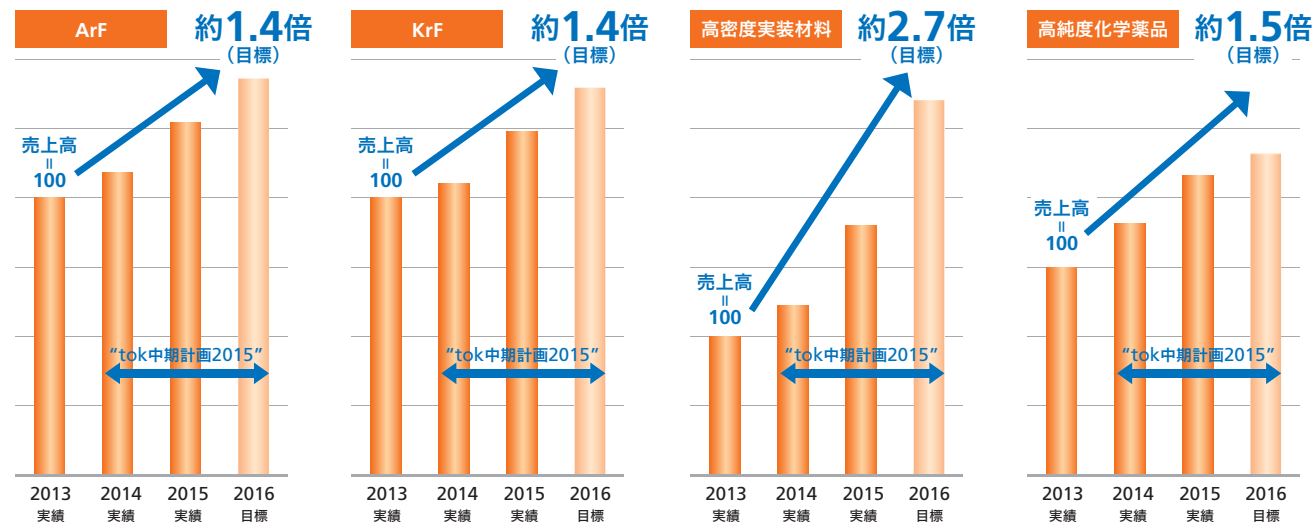
当初計画より遅れてはいるものの、新規事業領域であるTSV装置の売上高は、半導体業界における3次元実装市場が立ち上がり始めたことから、拡大基調にあります。

また、太陽電池パネルの生産効率向上に大きく貢献する結晶系塗布型拡散剤「EPLUS®」を開発し、拡販に取り組んでいます。このほかオプトエレクトロニクス、ライフサイエンス、蓄電材料、IoTなどの新規事業候補のテーマ探索を強化しています。

次期中期計画も視野に入れ、有望案件のステージアップと事業化に向けた取り組みを、地道にPDCAサイクルを実践しながら加速してまいります。

収益の3本柱と高純度化学薬品の売上目標

3月31日に終了した連結会計年度



(注)ArF、KrFの売上推移は、2014年3月期における販路変更に伴う影響を考慮した数値を用い作成しています。

資本効率と株主価値の向上へ向けて

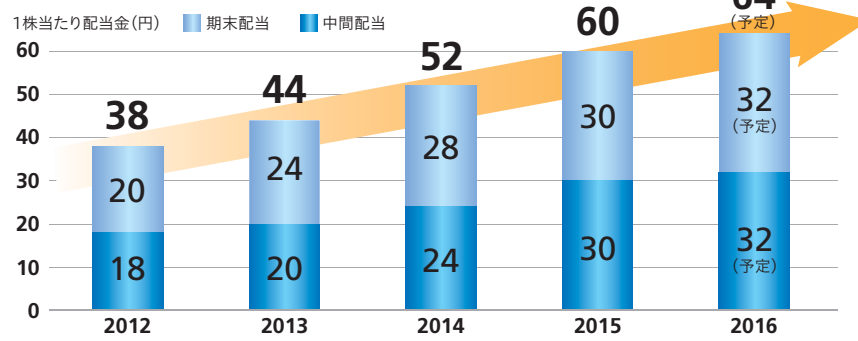
ROE目標数値と達成への道筋を次期中期計画で明確化

2015年3月期における当社のROEは、前期比0.4ポイント上昇して6.2%となりました。過去最高の当期純利益を上げながらもROEが6%水準となっている背景としては、高い自己資本比率(84.3%)や、最高益更新と同時に円安が進行し、為替換算調整勘定が増大してきたことなどがあると分析しています。

今後も収益拡大を目指して成長戦略を推進する一方、当社グループと株主・投資家の皆様との関わりにおいて、ROEのさらなる向上は不可欠であると強く認識しています。

そのためROEの目標数値および達成への道筋を、次期中期計画で明確化する予定です。現在、次期中期計画の最終年度である2019年3月期におけるROE目標値と、その達成へ向けた重点施策について、分子(利益向上策)/分母(資本政策)の両面から、入念に策定を進めています。

配当/配当性向の推移



2016年3月期の連結業績見通し

売上高	96,700百万円	(前期比9.8%増)
営業利益	13,300百万円	(前期比0.4%増)
親会社株主に帰属する当期純利益	9,000百万円	(前期比2.1%増)

*創立75周年記念配当4円を含む

連結EPS	84.86円	121.69円	168.54円	196.61円	200.56円
配当性向	44.8%	36.2%	30.9%	30.5%	31.9%

株主還元方針

当社グループは、株主各位への利益還元を経営上の重要課題の一つと位置づけており、長期的な視点に立ち、財政状態や業績等を総合的に勘案したうえで株主還元を実施していきます。今後も財政状態や業績等を総合的に勘案したうえで、競争力の強化や収益拡大につながる内部留保を確保していきますが、配当については、現在の水準を考慮しつつ、連結配当性向30%以上の配当を継続的に実施することを基本方針としています。

この方針に基づき、2015年3月期の配当金は、前期に比べ1株につき8円増配の60円(連結配当性向30.5%)とさせていただきます。

2016年3月期は、上記の業績見通しに基づき、配当性向31.9%、1株当たり普通配当に創立75周年記念配当4円を加え64円を予定しております。

株主還元のさらなる充実へ向けて自己株式を取得

長期的な見地からの株主還元策の一環として、自己株式の取得も弾力的に実施していく方針です。このたび、175万株または70億円を上限とした自己株式の取得を実施(2015年5月11日~7月10日)するとともに、保有自己株式150万株の消却(2015年9月16日)を行いました。

今回7年ぶりに自己株式取得を決定した理由は、過去最高益という好業績と、中計3カ年において必要な設備投資金額をいま一度精査した結果、今後必要な水準を十分に確保したうえでも、当初の投資見込み(335億円)を下回ったことによるものです。

今後も株主還元と成長投資のバランスを見ながら、弾力的に自己株式取得を検討してまいります。配当政策やROE向上策とあわせて改めて基本方針を策定し、次期中期計画の内容とともに、皆様にお知らせする予定です。

持続的成長基盤を支えるCSR活動

ステークホルダーとの協働においても経営陣がリーダーシップを発揮

当社グループは、おかげさまで本年10月に創立75周年を迎えます。

私たちがここまで事業活動を継続し、社会への提供価値を実現し続けることができたのも、株主・投資家の皆様に加え、顧客・取引先、従業員、地域社会など、全てのステークホルダーの方々との良好な関係があってこそのもであると認識しております。

東京応化は、今後も微細加工技術を磨き、顧客密着戦略

に徹することで、顧客への提供価値を最大化していくとともに、株主・投資家の皆様、取引先、従業員、地域社会の方々との協働を深め、持続可能な社会の形成に向けて積極的に貢献していきます。

これら一連の取り組みにおいても、私を含めた経営陣全員がリーダーシップを発揮し、率先垂範しながら、当社の持続的成長と中長期的な提供価値、企業価値の拡大に邁進いたします。

皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

社長・アナリスト対談



東京応化工業株式会社 代表取締役 取締役社長 阿久津 郁夫

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 エクイティリサーチ部 シニアアナリスト 尾脇 庸仁

東京応化工業の足元の事業動向、事業投資、財務・資本戦略について、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の化学セクターアナリストである尾脇庸仁氏をお招きし、当社取締役社長の阿久津郁夫との対談を実施しました。

足元の事業動向について

尾脇 2015年3月期は、過去最高の利益となりましたが、要因はどのようなものかと考えていますか。また、2016年3月期の業績見通しおよび足元の状況について教えてください。

阿久津 2015年3月期の過去最高益には、円安の進展に伴う為替要因や高付加価値製品の売上増加、また、リーマンショック後に不採算事業から撤退したことで収益体質が改善したことなど、多くの要因があると考えています。一方で、2016年3月期の業績予想については、売上は伸びるものの減価償却費等の経費増加により、“tok中期計画2015”の最終年度として当初掲げた営業利益150億円の達成は難しく、利益は前期比横ばいの計画(133億円)となっています。このような計画の中で、足元の第1四半期については、四半期決算が始まって以降、過去最高の営業利益となる38億円を計上しており、状況は悪くないと認識し

ていますが、第2四半期以降は減価償却費や修繕費などの経費の増加や半導体市況の軟調も見込まれていることから、楽観視はできないと考えています。

尾脇 韓国のTOK先端材料株式会社の稼働はどのような状況ですか。

阿久津 2014年12月に生産移管が完了し、足元では当初の生産計画を上回る状況が続いており、好調に稼働しています。同社は、先端フォトレジストの研究開発拠点も併設しており、韓国の大手顧客との迅速な情報のやり取りが可能になったことから、従来はなかなか採用に結びつかなかったロジック分野での採用を獲得するなど、着実に効果が現れています。今後も研究開発に注力し、最先端フォトレジストが採用され、業績拡大に貢献するものと期待しています。

事業投資について

尾脇

キャッシュの使い道として、最良の方法は本業で有効に使うことであると考えています。外部から見ていると東京応化の材料事業は、研究開発や設備投資など、半導体関連材料を軸に上手くいっていると思いますが、装置事業は今後の成長が材料事業のように見込めないように映ります。とは言うものの、装置事業を売却してキャッシュを積み増す事も良策とは思えず、TSV市場が立ち上がるのを待っている戦略で、装置事業の成長はあるのでしょうか。



阿久津

装置事業は、需給の浮き沈みが激しく、現状の業績は厳しい状況が続いています。TSV装置だけに依存するのでは、今後の成長は難しいと考えており、第2・第3の柱を作るべく開発に取り組んでいます。新たな装置として、UVキュア装置や次世代フレキシブルディスプレイ製造装置などの展開を進めており、手ごたえも感じていますので、TSV装置+αでの成長を目指していきたいと考えています。また、2016年3月期においては、TSV用材料の売上増加も見込んでおり、材料事業との相乗効果も出てきています。

ROE等財務戦略およびガバナンスについて

尾脇

投資の効率化に対する考え方が株式市場で変化しています。ROEや資産効率の議論は、過去に何度も取り上げられていますが、今回は特別に盛り上がっていると思っています。現在の世の中の風潮としては、高い収益率を上げているにもかかわらず、ROEが8%を超えていない会社は世の中の期待に応えていないかのように映ることすらあります。

自分自身の20年以上のアナリスト経験として、現在は少しROE至上主義に偏重しているくらいがあると思っています。このため、ROEを過度に重視していると感じられる会社に対しては、「信念を持って経営してほしい。」と話しています。

しかし、それも程度の問題であり、東京応化は、キャッシュの保有比率が高すぎるのが、経営上の課題であることは間違いなく、世の中の流れに迎合する必要はありませんが、その場合でも多額のキャッシュを持つうえでの信念は必要であると思っています。

阿久津

ROEに対するここ1~2年の注目度の高まりは、肌で強く感じています。当社のキャッシュの適切な保有水準は、現時点では明確にお示しできないものの、何らかのバランスは考慮しなければならないと考えています。最適な資本構成・比率について、中長期的なバランスを見てシミュレーションを実行していくために、現在、係数的な指標の準備を検討しており、内容が固まった段階で市場に対して説明できるようにしていきたいと考えています。また、当社は事業規模からすると保有キャッシュが多いことは認識していますが、競合他社は多角的に事業を展開し、資産規模も大きな企業であり、設備投資やM&Aなどに迅速に対応するには、ある程度のまとまった額は必要であると考えています。

尾脇

東京応化が置かれている事業環境や競争相手が巨大企業であることから、100億円単位の最低資金が必要なことは理解できます。株式市場が懸念しているのは、上限のない現金の積み増しであり、基準となるモノサシを設けることが重要です。金額の絶対額でも比率でも構いませんが、基準となるコップの形(考え方)と大きさ(その定量基準)が判ることが重要であり、そこから溢れた分は、株主に還元するという明確な指標の設定が投資家に安心感を与えます。化学メーカーにおいても現金保有額の目標水準を開示している企業はあります。投資家に対するメッセージとして、コップの大きさと形を示すことは有効だと考えます。

尾脇

6月より独立役員が2名増えましたが(社外取締役1名、社外監査役1名)、メリットやデメリットは感じていますか。

阿久津

社外取締役の増員に対しては、デメリットは少ないと考えています。業界の異なる経営者や専門家の方々から意見をもらえるのは、良い刺激になると思います。



尾脇

目標とするROEや社外取締役の増員などにより、社長とはこうあるべきというルールが決められ、社長としての選択範囲が狭くなっていると感じています。社長本来の持ち味や個性が発揮しづらくすることはないでしょうか。

阿久津

長く経営者を務めると本人が意識しないうちに、時としてたがが外れてくることもあるかもしれません。投資家や社外取締役など、外部の意見・考えを意識することで、緊張感を持った経営ができるという意味で良いことであると思います。

配当・自己株取得について

尾脇

北米・香港の投資家は自己株買いを好み、欧州の投資家は配当を好む傾向があると思います。自己株買いは、その時点で株式を保有している株主のみが利益を享受できるものです。しかし増配の効果は、これからその会社の株式を買う「将来の株主」にも及びます。また、減配は世界中どこかの経営者も避けたいとの思いが強いため、増配することは将来の業績に対する経営者の自信と覚悟の表れと見ることができます。

自己株買いは、資金フローとしてはエクイティファイナンスの逆です。教科書的には、資金が必要であれば株式を発行して資金を調達し、資金が余れば自己株買いをすれば良いとされています。しかしながら、日本の株式市場は、金融危機などが起こるとエクイティファイナンス市場が実質的に凍結してしまうことがありますので、いつでもファイナンスできるとは限りません。つまり現実的には、自己株買いとエクイティファイナンスは符号が逆だけの経済行為であると、単純に考えることも難しいのです。

阿久津

株主還元については、設備投資とのバランスを考慮したうえで、実施していくことを基本的な考えとしており、配当については、安定配当を基本に6期連続の増配を実施しました。また、5月に実施した自己株式の取得は、「tok中期計画2015」において、2016年3月までに実施する予定だった新規事業への投資金額と投資スケジュールを変更したことから、当初計画に比べ75億円程度の差額が生じたため、ROE向上策の一環として70億円の自己株取得を決断しました。また、前段でもお話させていただいたとおり、迅速な経営判断のためには、ある程度のまとまった待機資金が必要と考え、保有していることから、外部からの資金調達については、現時点では検討していません。

最後に

尾脇

証券アナリストの重要な仕事の一つは、各事業会社の打ち出している経営方針や基本的な戦略を、可能な限り客観的かつ論理的に吟味し、自らの意見として株式市場に伝えていくことだと思っています。同時に、事業会社に対しては、その会社に対する株式市場の期待の内容や大きさを正確に伝え、ある施策や戦略に対して市場がどう受け止めるかを予測することも重要だと考えています。

阿久津

業界に精通したアナリストの方々のご意見には貴重なものが多く、今後も忌憚のないご意見をいただきたいと思っています。

尾脇 庸仁氏 プロフィール

1992年株式会社野村総合研究所入社、2000年より化学セクター担当。JPモルガン証券株式会社を経て、2013年より現職。

材料事業 Material Business

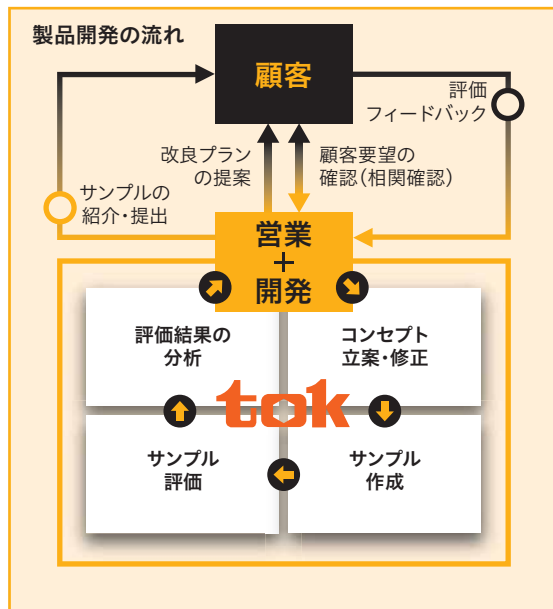
エレクトロニクス機能材料、高純度化学薬品の製造・販売



— 顧客密着型ビジネスモデル —

顧客密着戦略

高度化・多様化する顧客ニーズを的確に把握し、顧客ニーズを満たすべく、「開発力」「製造力(技術力・生産力)」「販売力(マーケティング)」などの総合力で結果をスピーディに提供する顧客密着戦略に注力しています。



2015年3月期の概況

売上高、営業利益とも過去最高を更新

エレクトロニクス業界においてはパソコン需要の落ち込みが和らいだことに加え、スマートフォンやタブレット端末等の需要が引き続き拡大しました。これを背景に半導体市場が活況を呈する中、顧客密着戦略に注力した結果、アジアおよび北米地域において、KrF用フォトレジストやArF用フォトレジストなど半導体用フォトレジストの売上が大きく拡大しました。

高密度実装材料においても、半導体パッケージ用厚膜レジストやMEMS用永久レジスト等が、アジア、北米地域で好調に推移しました。

LCD材料は減収となったものの、高純度化学薬品が伸長し、台湾顧客向けに現像液やシンナー、北米顧客向けに剥離液の販売が拡大しました。

これらの結果、売上高は前期比16.1%増となり、当セグメントの過去最高を更新しました。

営業利益は、売上拡大に加えて為替変動の影響(2014年3月期:99.3円→2015年3月期:109.3円)も押し上げ要因となって前期比16.1%増となり、当セグメントの過去最高となりました。

市場環境

半導体の集積度向上競争が新局面に突入

スマートフォンやウェアラブル端末の進化やクラウド用サーバーの高性能化、IoT市場の本格化に伴い、半導体の集積度向上競争の主戦場は、1Xnm(10nm台)世代にシフトしています。また2次元での集積度向上は限界に近づいていることから、3D-NAND市場が拡大し始めています。

当社は1Xnm世代ではArF用フォトレジスト、3D-NAND市場ではKrF用フォトレジストで世界トップクラスのシェアと顧客に密着した研究開発体制を有しており、この強みを最大限に伸ばしていく構えです。

成長戦略

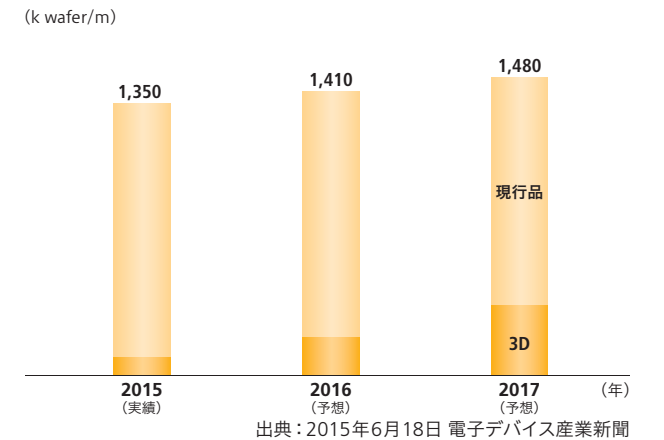
3D-NAND市場でKrF用フォトレジストの強みを極大化

NAND型フラッシュメモリの立体的積層化(3次元化)工程において、KrF用フォトレジストの新たなニーズが拡大しています。これは最先端ArF用フォトレジストに求められる微細化対応と異なり、積層化(3次元化)に向けた厚膜レジストとしての膜厚特性等が求められているためです。現在、日本・韓国の大手NAND型フラッシュメモリーメーカーを中心に量産準備が進められ、当社は大手顧客からの採用を獲得しています。

3D-NANDはHDDに代わるSSD向けの用途が拡大しており、処理速度の高さから、ネットゲーム用サーバーやデータセンター、パソコン等での需要が拡大しています。2016年末には、NAND型フラッシュメモリー全体の2割弱を3D-NANDが占めると予測されています。

当社は今後も積層数の増加に合わせた特性改善をさらに進めていくことで採用数を増やし、KrF用フォトレジスト市場における世界トップシェアのポジションをさらに盤石なものにしていきます。

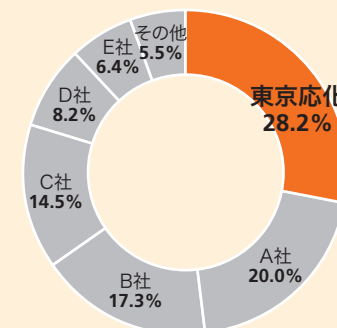
NAND型フラッシュメモリー市場におけるウエハ投入能力



材料事業の業績推移と見通し

	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期	2014年 3月期	2015年3月期(実績)			2016年3月期(予想)		
					増減	増減率	増減	増減	増減率	
売上高	71,482	66,645	67,697	72,866	84,611	+11,744	+16.1%	92,300	+7,688	+9.1%
エレクトロニクス機能材料	42,573	43,246	43,116	43,261	49,818	+6,556	+15.2%	54,600	+4,781	+9.6%
高純度化学薬品	25,124	22,789	24,144	29,194	34,844	+5,650	+19.4%	37,500	+2,655	+7.6%
その他	3,693	609	435	410	(52)	(463)	-	200	+252	
営業利益	10,796	8,303	10,716	14,086	16,355	+2,269	+16.1%	16,400	+44	+0.3%
営業利益率	15.1%	12.5%	15.8%	19.3%	19.3%			17.8%		
セグメント資産	61,921	57,798	68,686	79,147	92,440					
減価償却費	3,787	3,526	3,221	2,241	3,894					

KrF用フォトレジストの世界シェア



(2014年実績)	
企業名	販売数量(千ガロン)
東京応化	155
A社	110
B社	95
C社	80
D社	45
E社	35
その他	30
合計	550

出典：富士経済『2015年 半導体材料市場の現状と将来展望』

- 複数の収益ドライバ
(ArF、KrF、高密度実装材料、高純度化学薬品)
- 韓国・台湾・北米での顧客密着戦略
- 最先端の微細化・高純度化における技術開発力

S
強み

W
弱み

材料事業のSWOT分析表

- 技術代替サイクルの加速による採用機会の増加
- 中国での半導体市場の拡大
- IoT分野での技術展開

O
機会

T
脅威

- 顧客数減少の一方、レジストメーカーの競合数は不変
- 事業領域がエレクトロニクス業界に偏っている
- 業界の商習慣として、値上げが認められにくい

- 合従連衡による顧客数の減少
- 超高純度化に伴う、検査設備・生産設備投資の増加
- 次世代露光装置の高コスト化



フラッグシップ：ArF用フォトレジスト



ArF用フォトレジストによる回路パターン

線幅：21nm
(髪の毛の太さの約5,000分の1)

ArF液浸用フォトレジスト最終世代での勝利に向けて

ArF液浸用フォトレジストの最終世代とされている1Xnm世代の開発競争は最終局面を迎えています。当社は、顧客によるフォトレジストの評価方法そのものが変化している点に着目しながら開発を進めています。

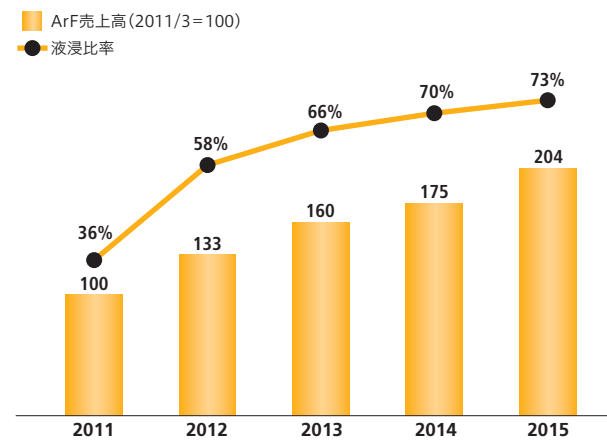
半導体メーカーが新プロセスを立ち上げる際、以前なら各レジストメーカーの製品を横並びで一斉に評価していましたが、最先端プロセスでは、旧プロセスから継続して使用できるフォトレジストはそのまま継続採用し、新プロセスでの要求性能が高まるフォトレジストのみを見直す傾向が強まっています。

見直しが行われるフォトレジストについても、一斉に評価テストが行われるのではなく、まずは、現在採用されているメーカーに対し性能向上が要求されます。従って、顧客から声がかかりやすい状況にあること＝顧客密着戦略が重要となります。

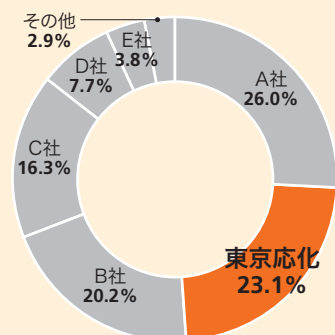
また、顧客の新プロセスで使用されるフォトレジストが従来品より優れている場合、量産立ち上げ中のプロセスにまで遡及して切替えが行われる場合もあることから、新プロセスでの優位性を求めることが、液浸以外も含むArF用フォトレジスト製品全体の競争力を高めることにつながります。

当社はArF液浸用フォトレジストにおいて現時点で世界トップクラスのシェアを有していますが、同製品が用いられる1Xnm世代の半導体は今後もスマートフォンやタブレット、ウェアラブル端末向けの成長が続く見込みであることから、引き続き顧客密着戦略に注力し、シェアをさらに拡大していく方針です。

ArF用フォトレジストの売上高推移/液浸比率



ArF液浸用フォトレジストの世界シェア



(2014年実績)	
企業名	販売数量 (千ガロン)
A社	27
東京応化	24
B社	21
C社	17
D社	8
E社	4
その他	3
合計	104

出典：富士経済『2015年 半導体材料市場の現状と将来展望』



インサイト

フォトレジスト市場

日本メーカーの高いプレゼンス

日本の化学メーカーの多くが世界に冠たる実力を持ち、多くの化学素材でトップシェアを有していますが、フォトレジストも例外ではありません。ArF用フォトレジストでは約90%、KrF用フォトレジストでは約85%の世界シェアを日本メーカーが占めています。

この背景としては、日本の各レジストメーカーの実力が高水準であることに加え、ポリマー/樹脂や光酸発生剤と

いったレジストの主要原料を供給する化学メーカーにも日本企業が多く、サプライチェーンの川上から川下まで一貫して品質の高位安定化を図ることができる点があげられます。

日本のモノ作りの強さの源泉の一つとして「摺り合わせ」の文化がありますが、顧客ニーズの細部をフォトレジストメーカーと原料メーカーが共有し、性能・スペック等をきめ細かく摺り合わせることで、高品質のフォトレジスト製造を実現しています。

フォトレジストのサプライチェーン (KrF・ArF用フォトレジストの例)



ArF用フォトレジスト、KrF用フォトレジスト市場の長期展望

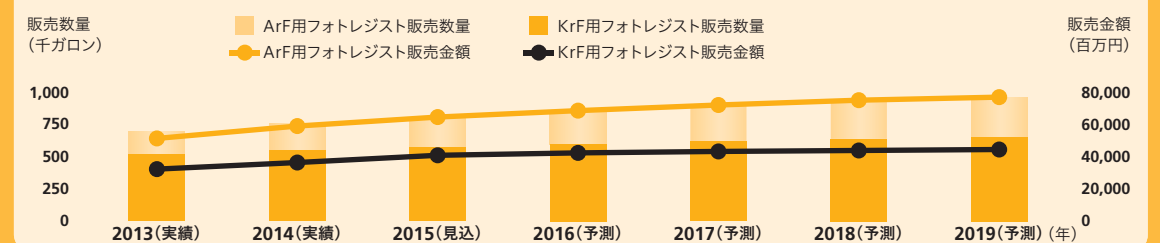
ArF用フォトレジストの世界市場(販売金額)は、2014年～2019年の平均成長率として7.9%、KrF用フォトレジストは同4.1%の成長が予測されています。

ArF用フォトレジストは足元においてはスマートフォンやタブレット端末用半導体向けに伸びていますが、今後も半

導体デバイスの大容量化、高速化、高集積化の進展により微細化の世代交代が進むことから、長期的な需要拡大が見込まれています。

微細化が最も進んだ分野ではKrFからArFへの切り替えが進んでいますが、最先端デバイスでもKrFで回路形成するレイヤーが一定数あるほか、3D-NAND向けの用途も拡大していることから、KrF用フォトレジストにおいても堅調な需要が続く見通しです。

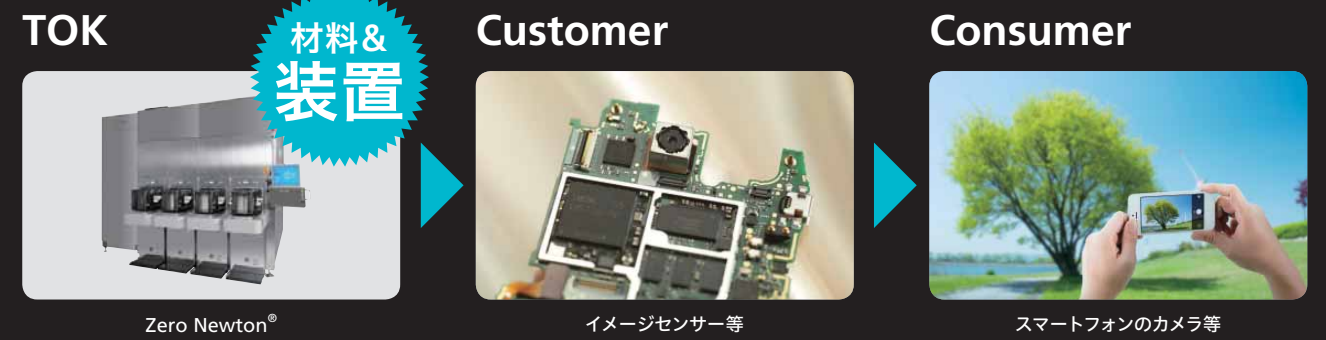
ArF用フォトレジスト、KrF用フォトレジストの世界市場規模予測



出典：富士経済『2015年 半導体材料市場の現状と将来展望』を基に作成

装置事業 Equipment Business

半導体製造装置、液晶パネル製造装置の製造・販売、保守

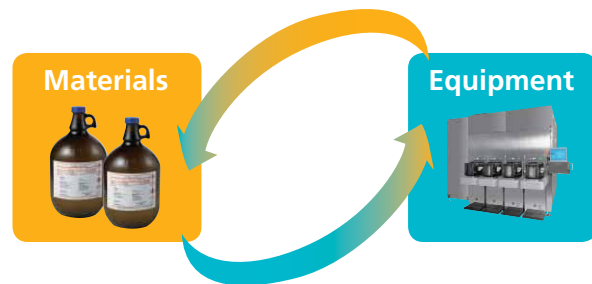


— M & E 戦略 —

半導体関連分野や液晶関連分野における先端技術において、材料事業と装置事業が連携し、相乗効果を生み出すM&E (Materials & Equipment) 戦略を展開しています。

特に半導体関連分野では、ムーアの法則が限界に近づいており、リソグラフィ技術も物理的限界を迎えようとしています。そこで新たな技術である3D-NAND向けのフォトリソでの競争力強化に注力するとともに、装置事業では3次元実装技術の一つであるシリコン貫通電極形成システム「Zero Newton®」に注力することで2次元および3次元実装の両市場での優位性強化に邁進していきます。

半導体の2次元、3次元の両市場で優位性を強化



2015年3月期の概況

収支が改善

2015年3月期の装置事業においては、「Zero Newton®」や、半導体用装置、フレキシブルディスプレイ製造装置等の売上によって前期比9億円収支が改善し、黒字化しました。これは、原価低減努力に加え、半導体製造に関する3次元実装市場においてTSV (シリコン貫通電極) 需要が徐々に立ち上がり始め、それを着実に捉えたことによるものです。

当セグメントの位置づけ

装置事業の売上高は2015年3月期においては、当社グループ全体の4%弱となっており、投資家の皆様から「セグメント化する意義が薄い。」「材料事業セグメントに統合してはどうか。」とのご意見をいただくこともあります。装置事業は、材料事業とは異なり工場を持たず開発特化型のファブレス方式である点、材料事業に比べて受注から売上までのリードタイムが長い点のほか、製品1単位あたりのコストや価格が高額である点等において、材料事業と大きく異なる事業特性を持ちます。

M&E戦略を具現化させ、平面、3次元の双方の半導体市場で優位性を拡大していくには、まずは装置事業の規

模を着実に拡大させていくことが先決であり、同事業を独立セグメントとして強化することで、将来の収益ドライバーとしての育成を加速していく構えです。

市場環境

TSVを用いた3次元実装市場の動向

ナノスケールの微細加工により進展してきた半導体製造プロセスにとって、半導体の積層化は大きな分岐点です。半導体チップを縦方向に積層し、集積度を高める方式として、3D-NANDは既に実用段階に入りましたが、本命として最も期待度の高いTSVにおいても、実用市場が立ち上がり始めています。現在、当社のTSV装置への引き合いが徐々に活発化し、受注が拡大傾向にあります。

TSVにより3次元実装を施された半導体の用途は、イメージセンサーやクラウドサーバー、ハイエンドのコンピュータグラフィックが有力視されています。ネックであった高コスト構造についても長年取り組んできた原価低減策が効き始めており、顧客密着戦略を徹底することで、販売を拡大してまいります。

成長戦略

TSV市場での優位性確立へ向けて

当社はTSVについて、半導体積層化技術の主流になると想定し、早くから開発を進めてきました。この技術・ノウハウの蓄積を活かし、TSV市場における優位性確立に邁進します。

まずはコア製品である「Zero Newton®」を中心に、既存ユーザーはもちろん、新規ターゲットに向けた積極的なアプローチも進め、顧客基盤の拡大を図っていきます。



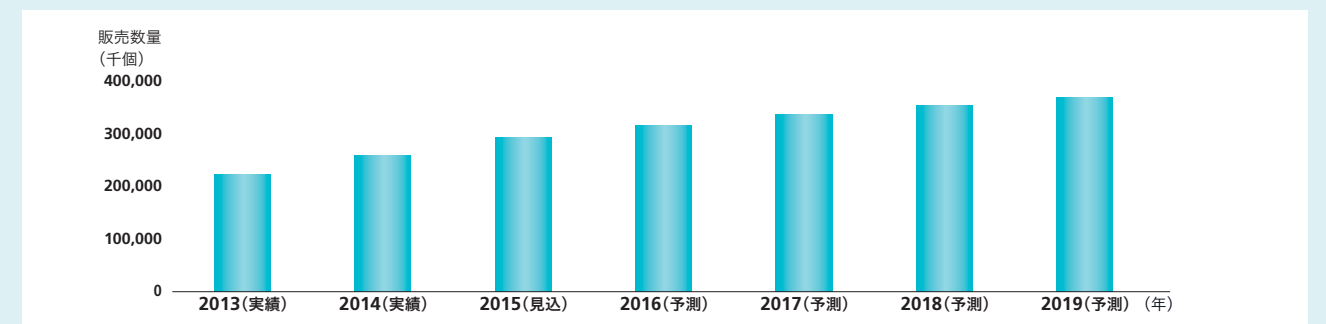
TSV装置
ウエハハンドリングシステム
Zero Newton®

装置事業の業績推移と見通し

	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期	2014年 3月期	2015年3月期(実績)			2016年3月期(予想)		
					増減	増減率		増減	増減率	
売上高	8,622	13,500	5,302	2,484	3,581	1,096	+44.2	4,400	924	+26.6%
営業損益	(1,381)	908	232	(889)	20	909	-	200	179	+887.5%
営業利益率	-	6.7%	4.4%	-	0.6%			4.5%		
セグメント資産	16,551	6,954	4,553	4,168	3,694					
減価償却費	269	203	254	204	167					

(注)2016年3月期の売上高予想値はセグメント消去後の数値を記載

TSVの市場規模予測(パッケージ数)



出典：富士経済「2015年 半導体材料市場の現状と将来展望」

- TSV装置がメモリー市場を中心に各社で採用
- ファブレス方式による損益分岐点の低減
- 早くから開発してきたことによる技術優位性
- 材料事業を通じて培った材料への知見

S
強み

W
弱み

装置事業のSWOT分析表

- 微細化の限界に伴う3次元実装市場の成長
- 液晶分野で培った高精細技術および塗布技術を活用
- 新市場のため、採用機会が平等

O
機会

T
脅威

- 市場黎明期にあることから、量産段階に入っていないことを背景とする高コスト構造
- プロセスコストが高いため、TSV市場の上昇が遅延
- 大手企業の本格参入
- 3次元実装において、当社が進める積層化以外の他社技術への代替

次世代ディスプレイデバイスの開発

液晶関連やディスプレイ関連においては、UVキュア（紫外線硬化）装置や次世代フレキシブルディスプレイ製造装置に注力します。

UVキュア装置は熱を用いずに高精細なTFTアレイ（Thin-Film Transistor Array：薄膜トランジスタの配列）の形成を可能にすることから、次世代型のスマートフォンやタブレット端末用の高精細ディスプレイでのニーズが高まっています。そこでTSVに続く収益の柱として強化するべく、中小型液晶パネルをターゲットに受注活動を積極化しています。現在、耐熱性・耐ドライエッチング性向上と剥離性を両立したUVキュア装置「TUV ssi シリーズ」のさらなる競争力強化と拡販に注力しています。

次世代フレキシブルディスプレイ製造装置においては、薄くて軽く、柔軟で丸めることのできるフレキシブルディスプレイが注目されていることから、電子ペーパーやフレキシブル有機EL向けに、新規製造装置を開発中です。主として、塗布装置、ベーク装置剥離装置を用いたプロセス開発に取り組んでいます。

装置事業における過去最高の営業利益は2007年3月期における3,007百万円ですが、当時の収益ドライバーは、液晶パネル用プロセス機器でした。液晶パネル市場の構造変化に伴い同分野での収益は減少しているものの、蓄積してきた豊富な技術・ノウハウを活かし、UVキュア装置や次世代フレキシブルディスプレイ装置での優位性の確立を図ります。



UVキュア装置

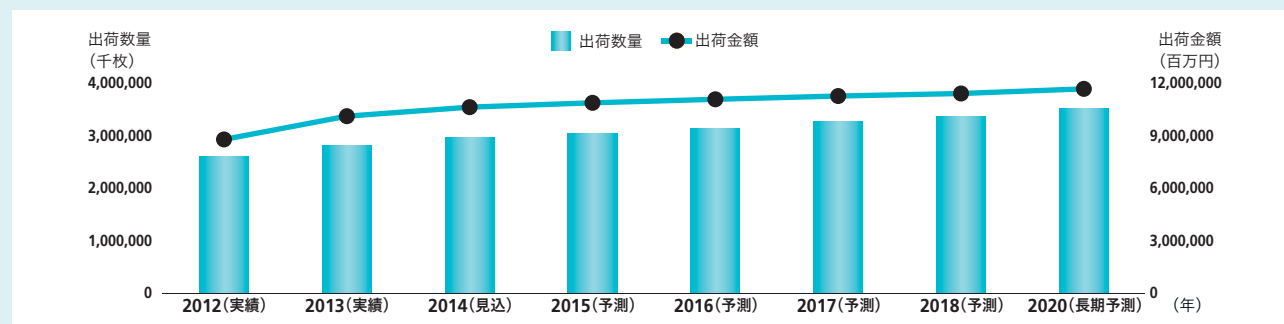


R&D用塗布装置



ベーク装置

液晶ディスプレイの市場規模予測等



出典：富士キメラ総研「2014ヒューマンインターフェース関連市場総調査」

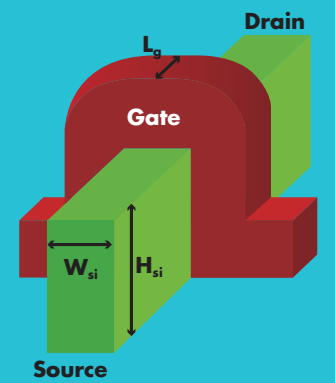


インサイト 半導体3次元化の3方式

“モアムーア（More Moore：ムーアの法則のさらなる進展）”を担う半導体の3次元化においては、現在、“FinFET”、“3D-NAND”、“TSV”の3つの方式が3大潮流となっています。

1. FinFET(3次元トランジスタ)

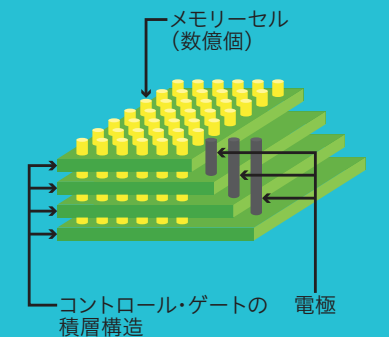
FinFETは、平面の基板上に3次元のゲート電極構造を立ち上げた形であり、基板面積が同一の場合、従来型のトランジスタに比べて、動作性能の向上や消費電力を大きく削減できます。2013年より実用が始まっており、この方式を用いた3次元半導体が、スマートフォン等に搭載されています。東京応化は、FinFET方式を用いる顧客の製造プロセスに対し、半導体用フォトリソトおよび高純度化学薬品などを提供しています。



FinFETの基本構造イメージ

2. 3D-NAND

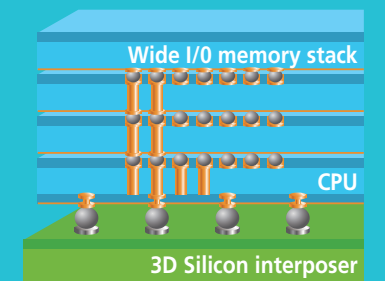
3D-NANDは、従来の2次元構造のNAND型フラッシュメモリーに比べて、縦方向にビット密度を稼ぐため、容量は同じでもチップ面積を小さくすることができます。現行のNAND型フラッシュメモリーでは、製造プロセスの微細化によって面積あたりの容量を増やしてきましたが、積層化によって2次元の微細化技術のみに依存する必要がなく、低コスト化が図れることから各NANDメーカーが取り組んでおり、2016年3月期より本格的な量産が見込まれています。東京応化は、大手顧客による3D-NAND製造に対し、KrF用フォトリソトを中心とする材料を提供しています。



3D-NANDの基本構造イメージ

3. TSV(Through silicon via)

チップ同士の接続をシリコン貫通電極で行う積層技術です。この方式を用いた3次元半導体市場の本格的な立ち上がりが見込まれています。TSVは、NAND、DRAM、Logicなど性能の異なる半導体を積層化することで、半導体チップを微細化に頼ることなく高密度化できる技術であり、用途が多岐にわたることから、積層化技術の本命とする意見が大勢を占めています。東京応化は、アジア、日本、米国の半導体メーカーを中心とする顧客にTSV装置やプロセス材料を提供し、受注が拡大傾向にあります。



TSVの基本構造イメージ



マーケティング戦略

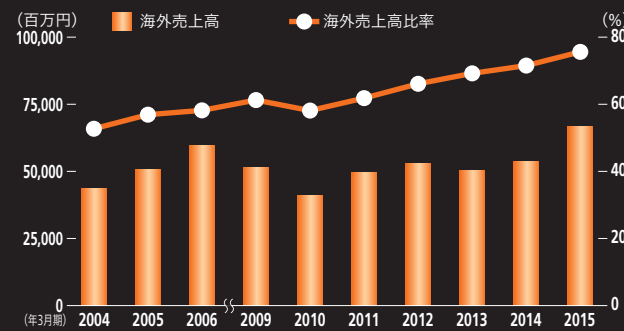
“ 顧客密着戦略をより深く、広く展開 ”

取締役 専務執行役員 営業本部長
TOK先端材料株式会社 代表理事社長
岩崎 光文

■ グローバル視点でのマーケティング戦略策定へ向けて

当社の海外売上高比率は年々高まっており、2015年3月期においては75%を超える水準となっています。海外顧客の存在感の高まりとともに、海外子会社の重要性や業績貢献度も増しており、東京応化グループとして、子会社の意向や現地ニーズを包含し、日本と海外子会社間における考え方や意識のズレを取り除き、ワールドワイドにマーケティ

東京応化の海外売上高推移



■ 顧客密着戦略をさらに拡充

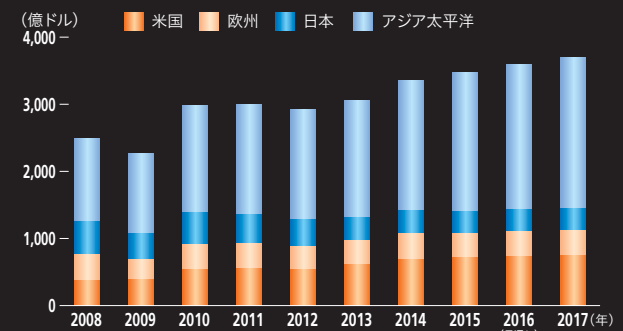
2013年より韓国のTOK先端材料社(TOKAM)で研究開発を開始したことで、韓国最大手の半導体メーカーより、数年前はゼロであった最先端ロジック半導体向けのArF液浸用フォトレジストの採用が獲得できたほか、従来、先端フォトレジストの採用に至らなかった顧客においても採用を得るなど、現地化の効果は目に見えて現われています。

まずスピード面において、従来の日本からの出張対応に比べて、TOKAMでは開発期間を3分の1程度に短縮で

テイング戦略の方向性を一致させることが、非常に重要であると認識しています。

そのため、各地域での営業、開発、フィールドエンジニアリング(顧客先に向いての技術業務)、製造など、マーケティングを含むビジネスの全工程のリソース配分を再度見直し、次期中期計画(2017年3月期~2019年3月期)での実践へ向けた戦略策定を進めています。

世界の半導体市場：地域別売上高の推移



きており、顧客からの高い信頼を勝ち得ています。現在、TOKAMでは、開発担当者や顧客間での技術交流が増加していることに加え、開発者自身が、データの取得、実装、サンプル製造までを行い、事前のスクリーニングやチューニングを現地で行うことができます。打ち合わせから数日で顧客にサンプルを届けることができるようになったほか、TOKAM内の最先端設備での評価により、顧客とのデータ相関性も確保できているため、品質面でも顧客からの信頼度が大きく向上しています。

半導体用フォトレジストの競争状況は依然として厳しいことには変わりありませんが、現地化により顧客との距離を時間的に短縮し、また品質面でも向上し、顧客とともに新たな製品を開発することで、これまで以上の信頼関係を構築していることは当社の大きな武器です。

韓国における現在までの採用実績や今後の最先端領域の成長性、また、政府の「Buy Korea」政策により韓国国内企業の製品が優先して購買される傾向にある点から見ても、最先端の研究開発拠点を韓国に設けたことは正解であったと考えています。



韓国の顧客密着戦略拠点：TOK先端材料株式会社(TOKAM)

■ プレゼンスが増大する中国市場に注目

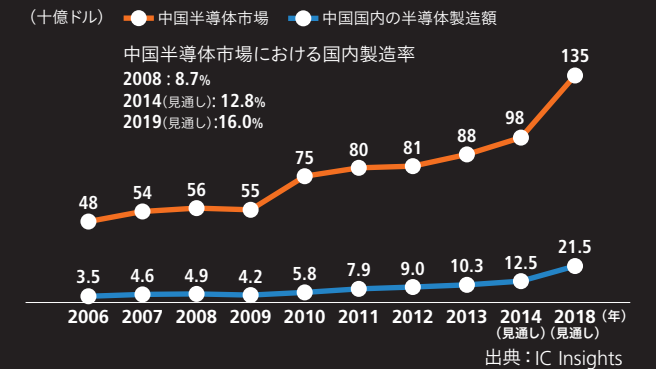
世界の半導体製造の中心地は現在のところ韓国・台湾・北米ですが、最先端分野も含めて、今後5~10年のうちに中国が世界最大の生産拠点になると想定しています。

現在の当社の中国ビジネスは、長春応化(常熟)社と上海駐在員事務所において、半導体やFPD関連材料、高純度化学薬品等の製造・販売を行っていますが、全社売上高に占める割合は約5%(2015年3月期)と高くありません。次期中期計画では、中国市場を対象とした施策を本格化するべく、具体的に準備していく必要があると考えています。

中国政府は半導体について、現在の輸入依存体制から国内生産へのシフトを図っており、今後年間1~2兆円規模のインフラ投資を予定しているとされています。中国国内での生産を目的としていることから、基礎研究からスタートするわけではなく、買収等による技術導入が進むと考えられます。半導体メーカーの買収や誘致から始まり、その後、ウエハ、フォトレジスト、ガスなどの材料メーカーが進出していくことで、2025年頃には、中国が1桁nm世代半導体の量産の中心地になっている可能性があります。

世界最大のB to C市場にB to B市場が形成されることの意味合いは大きく、インパクトのスケール感が違うと考えています。政府からの資金援助や優遇税制なども見込まれ、現在、韓国・台湾・北米の各デバイスメーカーもアクションを取っていますが、行政のシステムが時として障壁となり、一筋縄ではいかないことが多く、各社は悩みながら取り組みを進めています。当社も顧客や競合他社の動きを注視しながら、中国市場における顧客密着戦略の進め方を鋭意検討していきます。

中国半導体市場の成長性

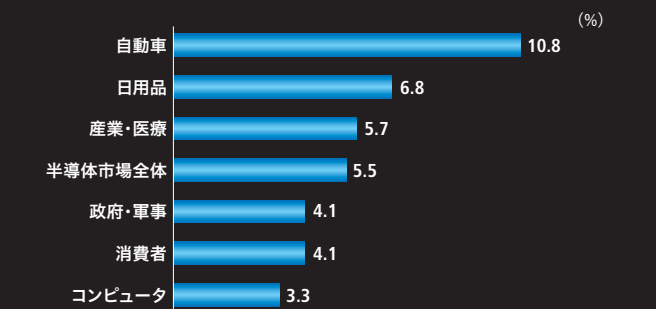


■ 車載関係を中心とするイメージセンサー市場の拡大に期待

ポストスマートフォン市場は、ウェアラブル端末も有力視されていますが、フォトレジストメーカーである当社としては、総合的に関与できる車載関係市場を最も有力視しています。これまでは車載関係市場に対する最先端の微細化技術の用途は限定的でしたが、今後は自動車におけるIoTの加速や自動運転化へ向けた動きが本格化するに伴い、例えばCMOSイメージセンサーといった半導体デバイスの用途が拡大していきます。この点において当社の微細加工技術が強みを発揮できる領域が広がると想定しています。

また、車載関係以外にも、イメージセンサー等の半導体デバイスの需要は増加していくと考えています。この分野では基礎材料開発が得意なメーカー等と競合しますが、顧客の開発・製造プロセスやニーズへの理解度・対応力においては当社に優位性があると認識しています。材料の使い方を熟知し、顧客ニーズをきめ細かく把握する当社は、明確な差別化ができると考えており、将来の事業としても伸ばしやすいと思います。

応用分野別(アプリケーション別)に見た半導体市場の年平均成長率(2013~2018年)



研究開発戦略

“ 半導体製造の
前工程・後工程において
最先端の価値提供を継続 ”

取締役 執行役員 開発本部長
佐藤 晴俊



■ 半導体前工程： 半導体集積度1Xnm(10nm台)以降での 取り組み

半導体の集積度向上における技術動向の一つとして、DSA*材料の開発については、1Xnmプロセスでの使用を前提に顧客と進めてきましたが、プロセス完成度の問題から、量産決定までにはもう少し時間がかかりそうです。

ArF液浸用フォトリソの次なる技術として注目されているEUV(Extreme Ultraviolet:極紫外線)は、光源性能の改善が進んでいることから実用化に向けて優勢な状況にあります。ロジック関係の半導体メーカーが中心となり、

2018年を目途に、10nm未満プロセスでの一部利用を目指して開発が進んでいます。当社もEUV用フォトリソの開発に向けて、ベルギーにあるコンソーシアム(IMEC)に研究者を派遣するとともに、顧客と協働しながらプロジェクトを進行しています。

2Xnm(20nm台)以下の最先端の微細加工技術においては、分子サイズでの性能の制御や付属薬品を含めた超高純度化対応など、技術難易度が格段に上昇しています。そのため開発においては、最初に顧客の求める特性・ニーズを明確に洗い出して把握する機能定義の徹底をこれまで以上に重視しています。また、要求特性をクリアするために、

国際半導体技術(ITRS)ロードマップ 2013年版		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MPU/ASIC Metal	ハーフピッチ (nm)	40	31.8	31.8	28.3	25.3	22.5	20.0	17.9	15.9	14.2
DRAM	ハーフピッチ (nm)	28	26	24	22	20	18	17	15	14	13
Flash	ハーフピッチ (nm)	18	17	15	14.2	13	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
最小ハーフピッチ	TOK レジスト/技術候補										
20~30 nm	ArF ダブルパターニング										
15~20 nm未満	ArF クアドロプルパターニング										
	EUV										
	ArF エクステンション/リソグラフィ補助										
	誘導自己組織化材料(DSA)+リソグラフィ										
10~15 nm未満	EUV ダブルパターニング										
	ArF クアドロプルパターニング										
	誘導自己組織化材料(DSA)+リソグラフィ										
	インプリント										
10nm未満	EUV エクステンション										
	DSA エクステンション										
	インプリント										
	技術革新										

原材料まで見直しを行い、PDCAサイクルを回していくことも従来以上に注力しています。

*DSA(Directed Self Assembly): 誘導自己組織化材料

■ 研究開発における顧客密着戦略を精緻化

研究開発においても、海外での顧客密着戦略を拡充していきます。韓国のTOK先端材料社では、最先端フォトリソの開発をスタートさせたほか、アメリカではクリーン・ソリューション(剥離液)の実験室を2013年に設置しました。台湾でも2015年に導入した新たな評価装置を活用し、今後の採用に向けた開発を本格化させていきます。半導体の微細化に伴い、技術難易度がますます上昇していることから、技術者も営業と一緒に顧客先で積極的に情報収集を行うなど、顧客密着戦略をさらに精緻化していく方針です。

■ 高純度化学薬品でも新たな付加価値を 絶え間なく提案

高純度化学薬品の中でも、剥離液は顧客のウエハでの性能評価が重要なため、レジスト開発以上に現地に密着する必要があります。台湾では、2015年に現地に実験室を設けてからより多くのニーズを把握できるようになり、開発テーマも増えてきているため、現地のエンジニアを増員する方針です。また、ニーズが出てから準備をするのでは遅いため、将来ニーズを見越した研究・開発を日本で先行させることで、顧客に新たな付加価値を絶え間なく提案していく体制にしていきたいと考えています。

■ 半導体後工程： パッケージ用材料での先行投資

半導体後工程における高精細化の進展により、パッケージ用材料へのニーズが高まっています。当社はかねてからこの分野の開発に取り組んできましたが、足元において順調に採用を伸ばすことができています。

これは、当社が後工程市場の拡大をかなり前から予想したうえで、要求特性等を勘案し、原材料となる新規ポリマーを地道に開発してきた成果です。

パッケージ用材料は最初の条件設定が難しいことから、導入時の立ち上げサポートを行うなど、顧客密着戦略による製品開発が重要となります。顧客ニーズに合わせたタイミングでの製品提供やファインチューニングに対するクイックなレスポンス体制が、当社の大きなアドバンテージ

になっています。

今後も世界各地で需要が高まっていく見通しであることから、グローバルな視点からの体制強化へ向けた先行投資も実施しています。さらに先のアプリケーションを見越した開発にも取り組んでおり、半導体後工程専門のコンソーシアムであるInstitute of Microelectronics (IME)(シンガポール)にも参加しています。現在IMEでは当社材料を用いたプロセスの構築が進められており、ここでの評価結果を基に、新規顧客からの引き合いが増加しています。

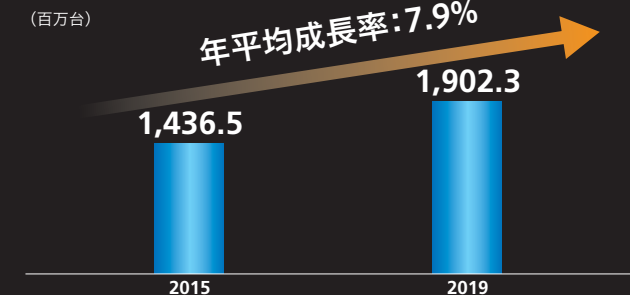
■ MEMS用材料の展開： 既存技術の応用が新たな提供価値を生む

MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)用材料では、フォトリソが永久膜となることで構造体を形成します。足元ではスマートフォンに代表される通信機器に搭載されるSAW*1・BAW*2フィルタ向けに売上が増加していますが、電子部品の小型化・高集積化を背景にリソグラフィ技術の適用ニーズが高まっていることから、これまで蓄積してきた技術を結集し、新規顧客・用途向けの開発を進めています。

例えばMEMS分野では液体レジスト以外にフィルムレジストへのニーズも高まっていますが、当社はかつてドライフィルムレジスト事業を展開する中で蓄積してきた技術をベースに、最先端MEMS用材料を開発しています。全く新しい技術開発も大切ですが、従来技術の他分野への展開や新たなアプリケーションでの有効活用も、今後の新たな提供価値の源泉の一つになると考えています。

*1 SAW(Surface Acoustic Wave)フィルタ: 表面弾性波フィルタ
*2 BAW(Bulk Acoustic Wave)フィルタ: バルク弾性波フィルタ

世界のスマートフォンの出荷台数予測



出典: Worldwide Smartphone Growth Expected to Slow to 10.4% in 2015, Down From 27.5% Growth in 2014, According to IDC, 25 Aug 2015

新規事業開発戦略

“ 世界初の製品を
世の中に送り出す ”

取締役 執行役員 新事業開発室長
駒野 博司

■ 新規事業開発の進捗状況

当社の事業ポートフォリオは材料事業の売上高比率が高く、新たな収益の柱となる新規事業の確立は、持続的かつ安定的な成長に欠かせないものです。長期ビジョンに掲げた通り、2021年3月期に新規事業で500億円の売上高達成を目指し、新規事業開発に邁進しています。

現在、「IoT (Internet of Things) 市場向けマイクロ二次電池」や「ライフサイエンス」などのテーマにおいて、“世界初の製品を世の中に送り出す”という挑戦を続けており、2015年3月期は、これらのテーマにおいて顧客へのサンプル提供ができるまでに成長しました。

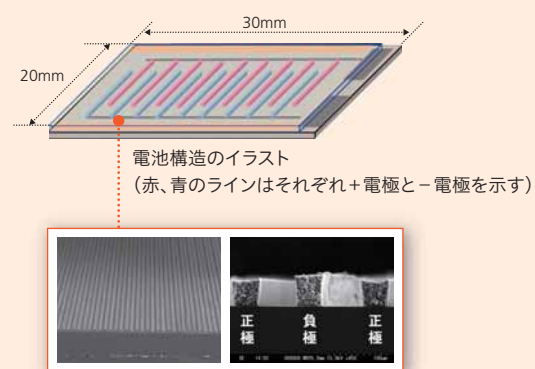
■ IoT市場向けマイクロ二次電池

IoT市場の拡大が加速するには、無数に搭載されるセンサー類への電力供給がポイントになります。このため、小型で微弱電流でも充電でき、大容量放電可能な超小型電池の実現が要望されています。

現在、当社ではコア技術であるフォトリソグラフィ技術を駆使し、ウエハ上に微細な電極を互い違いに配列させた超小型のリチウムイオン電池を開発しています。この「櫛形構造」と呼ばれる電極は、構造的に電池内部の抵抗を低くすることが可能であり、充電や放電時に多くの電流を取り出せるメリットがあります。このメリットを活かし、IoT分野やワイヤレスセンサーネットワーク*1分野において、電力を自給自足できるエネルギーハーベスティング*2なハイブリッド電源としての用途を想定しています。足元では、電池セルで重視される信頼性等のデータを増やしなが

国内外の顧客での評価を実施しています。また、電池の材料を供給するだけでなく、最終製品としてのデバイス化を目指し、コンソーシアムへ参加して共同研究開発を進めており、当社サンプルをワイヤレスセンサーデバイスに組み込んでの性能評価が実施されています。今後も当社電池のプレゼンスを高め、様々なデバイスとの組み合わせでの活用を実現すべく、研究開発を進め、世界初の電池を世に送り出すため邁進していきます。

マイクロ二次電池原理試作品の電池構造



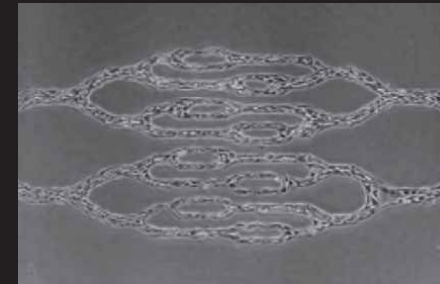
パターン形成後の櫛形電極写真

*1 ワイヤレスセンサーネットワーク：配置された多数の無線センサーからの温度、湿度、振動、圧力、明暗等、情報を収集することを可能とするネットワーク

*2 エネルギーハーベスティング：身の周りの光や熱、振動などの微弱なエネルギーを「収穫」する発電システム

■ ライフサイエンス

ライフサイエンス分野は、半導体微細加工で培った技術・知見の活かせる分野です。現在、創薬プロセスの効率化・低コスト化および病理診断の効率化を支援する抗体スクリーニングデバイス、マイクロ流路、細胞培養基材等の開発を進めています。



微細加工技術による毛細血管のパターン形成

■ ロードマップの無い市場でいかに勝負するか

新規事業開発が既存事業と大きく異なる点は、ロードマップが存在しない点です。開発者全員が、当社創業以来の精神である「困難であっても、社会に役立つ、他社が手掛けないような製品の開発に挑戦したい」という熱意を抱き、「世界初」そして「ニッチトップ」の実現に向けて邁進しています。

新規事業のターゲット市場は、変化が非常に速く、価格・性能の双方において、常に代替技術との競争が存在しています。半導体の微細化技術では2Xnm、1Xnmなど各世代、各レイヤーで勝敗（顧客からの採用）が決まりますが、代替技術のある市場においては、当社の技術が最高性能を出しても、代替技術の方が量産に適していれば当社の技術は必要なくなります。つまり、狙っている市場では、良いものを提供すれば採用されるわけではありません。

■ 出口戦略を明確にし、
ビジネスの本流を見極める

そのため代替技術との競争においては、出口戦略を明確にしたうえで、いかにして開発のスピードを上げるかが鍵であると考えています。特に重要なのは出口戦略であり、新規事業を成功させるには、ビジネスの本流を見極め、「この顧客は本当に勝ち組となり、この技術は本当に実用化されるのか」という先の先を読む目利き力が必要です。

新規事業をゴール（売上）まで持っていくには、この他にも多くのハードルがあります。技術開発における個人と組織のさらなる高機能化を図るとともに、ゴールするという情熱と最後まであきらめない気力、そしてプロフェッショナルとして本物の専門力を以て、事業化までのプロセスを粘り強く継続していく所存です。

■ 原点回帰の
「ソリューション提供型ビジネスモデル」

出口戦略を明確にする一方、当社の顧客密着戦略の原点である「ソリューション提供型ビジネスモデル」も念頭に新規事業の創出を進めていきます。

当社がフォトレジスト市場に1968年に参入し、後発であったにもかかわらず成功できた理由は、何十社もの競合他社が研究開発を行っていた中で、露光機や検査装置など顧客と同じ評価設備を備え、顧客と同じ目線で一緒にソリューションを作り上げるビジネスモデルを確立したことにあります。これは当社顧客密着戦略の原点として、新規事業を創出するうえでも有効なビジネスモデルであると考えています。

■ 次期中期計画への抱負

筋のいいテーマに巡り合えたこともあり、2021年3月期に新規事業分野で500億円／年の売上高達成に向けて、邁進しています。これらのテーマを育てていけば、100億円単位のビジネスになると見込んでいます。2017年3月期よりスタートする次期中期計画において具体的な実績をあげなければ2020年のゴールは遠のいてしまうため、開発者の総力を結集し、間違いのないアプローチのもと、種まきしたアイテムを確実に育てていきます。現在、上述した3テーマを含めて約20のテーマに取り組んでおり、そのうち3分の1程度が2021年3月期までに事業化できると見込んでいます。また、現在進めている多くの顧客・研究機関とのコラボレーションを進展させ、今後もさらなる連携強化を図っていきます。

人材開発戦略・攻めのガバナンス

“ 「稼ぐ力」の基盤づくりに挑む ”

取締役 執行役員 総務本部長
水木 國雄



■ 人材活用の基本方針

ここまで解説してきたマーケティング戦略、研究開発戦略、新規事業開発戦略を実践し、提供価値を拡大し続けるための全ての活動の根幹は、人材です。中長期的な収益性・生産性を高めること、すなわち、政府の「日本再興戦略」改訂2015の言葉を借りますと、「稼ぐ力」を強化することになりませんが、その源泉は、この人材を如何に育て、有効に活用するかにあると申し上げても過言ではないと思います。

東京応化では経営理念の一つでもある「自由闊達」の精神に則り、従業員一人ひとりにとって、生き生きと働ける職場、安全で健康に働ける職場作りに取り組んでいます。また創業以来一貫して「人材こそ企業の財産」を基本理念とし、全ての従業員が貴重な財産との認識のもと、「人材活用方針」を以下のように定めています。

- 事業の原点は、常に「人」であることを忘れてはならない
- 会社ならびに従業員相互間において、一切の差別の禁止
- 各種法規の遵守ならびに公平・公正な処遇
- 技術開発型企業を目指した、創造性溢れた人材の育成
- 成果主義に基づく、透明性を重視した人事制度

■ 人材開発プログラムを一新

東京応化がコアビジネスとする半導体関連市場の最先端分野では、熾烈な技術開発競争がグローバルに展開されており、その変化スピードと技術難易度は、年々高まっています。こうした中で当社が引き続き提供価値を拡大していくには、変化を先読みする情報収集能力と感性を備え、潜在的な市場ニーズを的確に捉え、スピーディに事業化できる人材の育成が不可欠です。そのため“tok中期計画2015”では、全社戦略の一つとして「グローバル人材開発」を掲

げ、以下の3点を満たす人材の育成を目指し、2014年3月期より、「階層別研修プログラム」を一新したほか、短期集中育成型の「TOKグローバル選抜教育」を実践しています。

1. 国内・国外を問わず、どのようなビジネスシーンでも自らリスクを背負いながら能力を発揮することが可能な自立型人材
2. 未知の世界、時に厳しい環境に、積極的に飛び込んでいく前向きな気持ち、姿勢、行動力を持って力を発揮することができる人材
3. 東京応化の社員であることのアイデンティティを失わず、しっかりとした価値観・存在感を持っている人材

■ TOKグローバル選抜教育

2014年3月期から新たにスタートした「TOKグローバル選抜教育」では、30歳前後の若手社員を中心に、「現行の職務で優秀な成績を残しているか」、「グローバルな舞台で積極的にチャレンジできる素質を持っているか」、「自らの職務に対して普段から問題意識を持ち、自らの言葉で説明できるか」、「将来の経営幹部たり得るか」といった視点で適任者を選抜し、海外研修を含む6か月にわたる中身の濃い選抜教育を実施しています。研修生には、異文化で育った外国人との英語でのコミュニケーション、win-winな



関係になるための交渉スキル、シンガポールでの数々のミッションを通じての外国での課題解決、リーダーシップ、メンタルタフネスなどの基礎を徹底的に叩き込み、研修の最後にはテーマを定め、経営陣とともに議論しています。

この教育制度を通じ、例えば顧客密着戦略では、国内外の多様な事業環境の中で相手と自分の違いを理解しながら受け入れ、自分はこれだけは誰にも負けないというスキルを持って渡り合い、顧客と協働しながらスピーディにビジネスを成し遂げる力を身につけることが、さらなる提供価値拡大に向けた大きな原動力になっていくものと考えています。本制度は当社グループのグローバル化の進展を加速する最も重要な鍵であると認識しており、グローバルに活躍する将来の幹部人材育成のため、しっかりと取り組んでいく構えです。

■ ダイバシティの深化で
新たな提供価値の創出へ

2014年3月期の新入社員の外国人比率は15%、女性比率は45%でした。2015年3月期も、外国人比率が10%、女性比率が40%と前期とほぼ遜色なく、当社のダイバシティ(多様性)マネジメントは着実に進展していると認識しています。ただし採用の幅を広げるだけでは不十分であり、グループ内の多様な人材をいかに有効に活用していくかが重要です。そこで前述の階層別研修プログラムおよびTOKグローバル選抜教育を、「ダイバシティ&インクルージョン」という企業文化を定着させる取り組みへもつなげていく考えです。

具体的には、当社グループの国内外の全従業員が東京応化グループの一員であることに誇りを持つとともに、自国の歴史や文化をしっかりと学び、強固なアイデンティティに立ったうえで、柔軟に外国の文化、習慣等も受け入れられる人材の育成に注力します。また、十分に自分の意見を主張すると同時に、相手の意見を傾聴することができる人材育成も加速することで、異なる価値観のぶつかり合いの中から全く新しい提供価値を創出していくような、アグレッシブな風土作りに邁進します。

■ 攻めのガバナンス

前段で触れたとおり、政府が日本企業の「稼ぐ力」を復活させるために次々に施策を打ち出しており、コーポレートガバナンス・コードの制定もその一環です。コーポレートガバナンスは、多義的でいくつもの解釈が成り立ち得る中で、私は「株主をはじめとするステークホルダーのために、適正にルールを遵守して業績および企業価値を最大化する仕組み」と要約することができます。

当社では、これまで、コンプライアンス、危機管理、情報管理の各体制の整備と運用に努める一方、執行役員制度の導入による取締役会改革、金融機関出身の社外監査役の2名から3名への増員を行いコーポレートガバナンスの強化に注力してきました。そして最近では、上場企業の経営経験者に加えて、内部統制に精通した公認会計士を招聘して社外取締役の複数化を図るなど、ガバナンス強化の取組みをさらに加速しています。こうした中、業績および企業価値の最大化という視点を疎かにしたことはありませんが、顧みると、どちらかと言えば守備重視、ダウンサイドリスク軽減の側面からのコーポレートガバナンス強化に注力してきた感もあります。

引き続き、企業価値の毀損を招くことが決してないように、グループ内部統制の強化を含め「守りのガバナンス」を徹底していくべきことは多言を要しません。今後は、さらに「攻めのガバナンス」という側面から計画的に体制の整備を進め、経営の様々な局面で、アクセルとブレーキを適時、適切に踏み分けられるようにしていきます。

当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨、精神に賛同し、これを全て遵守する考えに立っています。「攻めのガバナンス」という観点からは、社外役員の活用による取締役会の実効性のさらなる強化、経営陣の適切なリスクテイクを支える環境のさらなる整備、経営陣の適格性の維持等に取り組んでいます。

合わせて、スチュワードシップ・コードの制定によって、投資家との建設的な対話の重要性がますます高まっていることにも思いを致し、国内外でのSR(株主向け広報)/IR(投資家向け広報)を充実させ、適時、適正な情報の開示に努めるとともに、投資家、株主の皆様のご意見を傾聴することで、当社のコーポレートガバナンスのさらなるレベルアップにつなげたいと考えています。

社外取締役インタビュー

栗本社外取締役に、東京応化のコーポレート・ガバナンス、企業価値の向上、ステークホルダーとの協働についてインタビューを実施し、率直な意見をいただきました。



社外取締役(独立役員) 栗本 弘嗣

Q1 社外取締役の役割について、ご自身のお考えをお聞かせください。

独立役員としての責務を果たす一方、強い当事者意識を持って提言

代表取締役として上場企業の経営を8年間経験した身から見ても、コーポレートガバナンス・コードで提唱されている独立社外取締役の役割は、極めて理にかなったものであると思います。東京応化の持続的成長や中長期的な企業価値向上に向けて、同社の経営方針や経営改善に資するべく、私も積極的に提言していきます。

この役割を全うする一方、私は「社外取締役」の役割については、「社外取締役」=「社外」+「取締役」、すなわち社外取締役には「社外」という視点からの役割と、「取締役」の立場としての役割があるという考え方を持っています。

「社外」としての役割とは、会社と経営陣・株主等との間で利益相反が生じないかを監督するとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる責務です。これは一般的な「社外取締役」のイメージに近いと思います。

一方、私が個人的に重視したいと考えているのは、「取締役」としての役割です。社内取締役ほど東京応化の業務

に精通していなくても、「企業価値の向上に努める」という点では、社内外を問わず取締役としての使命は同じであると考えます。私が経営に携わっていたオイレス工業株式会社は機械メーカーであり、事業ドメインは東京応化と異なりますが、製造業としてのリスクテイクの勘所やメンタリティは、類似点が多いと思います。東京応化の成長につながるようなビジネス・リスクテイクであれば、これまでの経験を活かし、積極的に応援してまいります。同時に、あるべきコーポレート・ガバナンス(企業統治)を目指して、社内取締役の方々や監査役の方々とともに研鑽に励み、私自身も成長していきたいと思っています。

Q2 東京応化のコーポレート・ガバナンスをどのように評価していますか。

仕組み以前の問題として、経営陣の力量を信頼

昨年より日本企業のコーポレート・ガバナンス改革が加速していますが、東京応化も独立役員を1名増員するなど、この流れにしっかり沿った方向で動いていると認識しています。かつて経済学者のハーバート・サイモンが、全ての経済主体には「限定合理性」があると唱え、それを克服するための組織に着目したように、「どんなに優秀な経営者も、常に100%正しい判断ができるとは限らない」という認識のもとで企業経営に当たるべきと考えています。独立役員を増やす方針は、日本企業の競争力を正しい方向性で強化していくと考えます。

ただし最終的にガバナンスが機能するか否かを決定するのは、こうした制度面での「器」の整備だけでなく、「魂」に依る部分が大きいと考えています。東京応化の取締役会は、毎回丁寧かつ活発な審議が行われており、ガバナンスは確実に機能していると認識していますが、何よりも、社長をはじめとする経営陣の志の高さ、力量、倫理観といった「魂」がしっかりしていることをお伝えしたいと思います。

技術オリエントドの経営を金融機関出身者がサポート

社外監査役3名の全員が金融機関出身者である点も、特長の一つです。東京応化は研究開発型企業であり、今後もニッチトップであり続けるには、最先端分野において世界最高水準の技術力を保ち続けなければなりません。そのため開発や投資においては、技術開発者の意思を尊重することも大切ですが、これらを確実に収益へ結びつけ、ステークホルダーへの提供価値を担保するにあたっては、リスク管理を適切に行わなければなりません。

この点において、金融機関出身である社外監査役の提言は毎回示唆に富み、かつ実践的であり、着実に機能していると思います。例えば2014年度の取締役会においては、2年前から韓国で稼働しているTOK尖端材料社の投資回収計画が重要なテーマの一つでしたが、為替リスク対策をはじめ、金融機関出身者ならではの戦略的な提言が社外監査役より活発になされていました。

Q3 東京応化が持続的に成長し、企業価値を高め続けるために必要なことは何でしょうか。

顧客密着戦略のさらなる拡充と新規事業領域の拡大

今後の外部環境の留意点としては、半導体関連事業全体のロードマップが見えにくくなっている点があると思います。ムーアの法則の限界が近づきつつあるという説もあり、この業界において先を見通すのは、今後さらに難しくなっていくのではないのでしょうか。

だからこそ、現在注力している顧客密着戦略をさらに拡充していくべきだと思います。最先端を走る顧客との密接な関係を維持して変化を察知し続けるとともに、これまで本格展開してこなかった地域へも顧客密着戦略を広げていくべきだと思います。

もう一つのポイントは、新規事業領域の拡大です。事業の幅を広げることで、持続的成長がより安定的になると考えています。この点は経営陣も十分に認識しており、「tok中期計画2015」でも重点戦略の一つとなっています。課題

はどう開花させるかですが、やはり、トライ&エラーを繰り返すしかないでしょう。チャレンジを奨励し、失敗をとがめず、敗者復活戦のある風土は既に醸成されているようですが、これを維持したうえで持ち前の技術力を発揮すれば、必ず実を結ぶと思います。

資本効率の向上へ向けて

昨年度の営業利益率は15%と高水準にあり、利益成長が比較的安定的になってきていることから、ROE等の資本効率向上にも注力すべき段階にあると思いますが、ROEは現状伸び悩んでいます。ただし、これだけ最先端分野に注力していると、リスクに備えた十分なキャッシュも必要です。ポイントは適正なキャッシュ水準の設定だと思います。取締役会では次期中期計画に向けて、そのあたりの明確化へ向けた議論が始まっていますので、私も鋭意考察し、提言していきたいと思っています。

Q4 株主・投資家以外のステークホルダーとの協働にあたり、東京応化が今後取り組むべきことについてお聞かせください。

CSR活動を長く地道に継続するべき

株主・投資家以外のステークホルダーとの協働においては、CSR活動を地道に、長く続けていくべきだと思います。東京応化は、従業員との協働では「社長と若手社員が語り合う会」や「TOKグローバル人材育成プログラム」、地域社会との協働では各地域でのボランティア活動や教育支援などに取り組んでいますが、こうした活動を今後も地道に継続して行って欲しいと思います。そのためには、今後も社長や取締役が率先垂範して行動していくほか、活動のレビューを取締役会の議題とするなど、CSRにおいても経営陣のリーダーシップを強化していくことが有効ではないでしょうか。PDCAサイクルをしっかりと回すことが得意な東京応化にとって、親和性が高い方法であるとも思います。

コーポレート・ガバナンス体制

組織形態	監査役設置会社
取締役の人数	8名
うち、社外取締役の人数	2名
取締役の任期	1年
取締役へのインセンティブ付与	ストックオプション制度の導入
監査役の数	4名
うち、社外監査役の数	3名
独立役員の数	5名(社外取締役2名、社外監査役3名)
監査法人	有限責任監査法人トーマツ
執行役員制度の採用	有

基本的な考え方

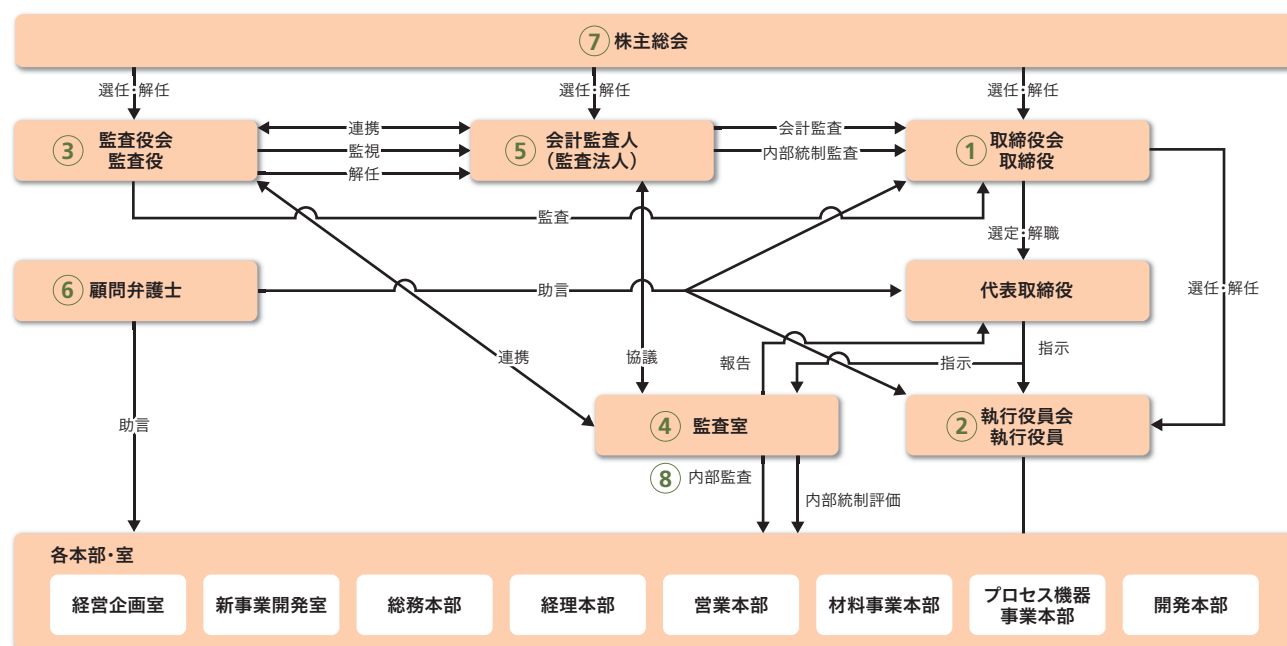
当社は、創業以来の経営理念(「技術のたゆまざる研鑽」「製品の高度化」「社会への貢献」「自由闊達」)のもとに掲げた「高付加価値製品による感動(満足できる性能、コスト、品質)を通じて、世界で信頼される企業グループを目指す。」という経営ビジョンを実現することが、株主の皆様をはじめ、多くのステークホルダーに共通する利益の実現ならびに企業価値の向上につながるものと確信しています。

この経営ビジョンの実現に向けて、経営の透明性、健全性ならびに意思決定の迅速化等による効率性の確保を目的としたコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つと位置づけ、その達成に向けて鋭意取り組んでいます。

機関設計の形態

監査役設置会社として、監査役制度を採用しています。その理由は、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実を図る一方で、取締役会の改革と執行役員制度の定着、さらには独立性を有する社外取締役の選任により、「経営意思決定・経営監督」および「業務執行」の各機能の強化と責任の明確化を図ることが、コーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断しているためです。

コーポレート・ガバナンス体制図(2015年6月25日現在)



取締役・取締役会(体制図①)

経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任を明確にするため、2006年6月より、取締役の任期を2年から1年に短縮しています。取締役会の透明性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的に、2015年6月より、独立性を有する社外取締役を2名選任しています。

取締役会は原則として「代表取締役」と「取締役」の二層にフラット化し、取締役に本来求められる「経営意思決定・経営監督」機能の発揮に適した体制としています。

2015年6月25日現在、取締役は8名(うち、社外取締役2名)です。業務執行に関する重要事項等を決定するとともに、代表取締役および取締役の職務執行を監督することを目的に、定時取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しています。

また取締役の員数を10名以内とする旨ならびに取締役の選任決議について、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以て行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めています。

執行役員・執行役員会(体制図②)

取締役会の「経営意思決定・経営監督」機能の充実を図る一方、業務執行機能のさらなる強化に向け、各執行役員が担当する職務の責任領域・能力等を総合的に勘案して、執行役員社長以下、執行役員副社長、専務執行役員、常務執行役員、執行役員という階層的な役位を設定するとともに、全執行役員で構成する執行役員会を設置しています。

2015年6月25日現在、執行役員は16名(うち、取締役を兼務する執行役員6名)です。取締役会における決定事項の指示・命令、執行役員相互の活動情報の共有化および取締役会付議基準未満の一定の重要事項の意思決定等を目的に、定時執行役員会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時執行役員会を開催しています。

監査役・監査役会(体制図③)

2015年6月25日現在、監査役は4名(うち、社外監査役3名)です。監査に関する重要事項について、各監査役から報告を受け、協議を行い、または決議することを目的に、定時監査役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。各監査役は、監査役会が定めた監査基準(監査役監査規程)に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会、執行役員会その他重要な会議に出席しています。また取締役等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めらる

どして、取締役の職務執行を監査しています。会計に関する事項については会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めらるなどして、監査の方法および結果の相当性を確認しています。

監査室(体制図④)

取締役社長直轄の組織として監査室(監査室員は5名)を設置し、業務活動に係る内部監査に加え、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を通じ、継続的改善のための指摘、提言、助言を行っています。

会計監査人(体制図⑤)

公正かつ独立的な立場から当社の会計監査を実施しています。2015年3月期の当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任監査法人トーマツの指定有限責任社員・業務執行社員の大中康宏氏および指定有限責任社員・業務執行社員の東海林雅人氏の2名です。また当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士5名、会計士補等3名、その他11名です。なお当社の会計監査人(有限責任監査法人トーマツ)に対する監査報酬の内容は次のとおりであり、当該報酬は、2015年3月期事業年度に係るものです。

・公認会計士法(1948年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく報酬:52百万円

顧問弁護士等(体制図⑥)

複数の法律事務所と顧問契約を締結し、法律上の判断を必要とする場合等には顧問弁護士より適宜助言を受けています。

株主総会の活性化および議決権行使の円滑化に向けて(体制図⑦)

集中日開催を回避するとともに、株主総会の議案内容の検討期間を法定日数よりも長く設定し、株主の皆様の議決権行使を促進するため、招集通知の早期発送(総会開催日の21日前(3週間前))に発送しています。また、株主総会に出席できない株主様の議決権行使について、書面による行使に加え、電磁的方法による行使(機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を含む)を可能にするるとともに、海外機関投資家の理解の一助とすべく、招集通知(英文)を作成しています。

また、株主総会に出席された株主様の理解促進を図るため、映像とナレーションを用いて報告事項の報告を行うとともに、招集通知、決議通知および株主総会議案の議決結果(いずれも和文および英文)を当社ホームページに掲載するなどの諸施策を講じています。

コーポレート・ガバナンス

監査役と内部監査部門、 会計監査人との連携

内部監査および監査役監査(体制図⑧)

【監査役と会計監査人の連携状況】

監査役は毎年2回以上、監査法人(会計監査人)より会計監査等の結果報告を受けています。また、毎年1回、監査法人(会計監査人)より監査計画について説明を受けています。さらに監査役は、毎年2回程度、取締役の職務執行監査の一環として、監査法人(会計監査人)が実施する工場往査に立ち会うとともに、監査法人(会計監査人)の監査の方法について調査しています。そのほか、必要に応じ監査役と監査法人(会計監査人)との間で情報交換や意見交換を行っています。

【内部監査、監査役監査および会計監査と内部統制部門との関係】

内部監査および財務報告に係る内部統制の有効性の評価を担当する監査室のほか、コンプライアンス、リスク管理等を所管する各部署を内部統制部門としています。

内部監査においては、内部統制部門である監査室が、監査した結果の報告を取締役社長、監査役および関係部署に対して行うとともに、必要に応じ関係部署に対し指摘、提言、助言を行っています。

監査役監査においては、監査役が、取締役の職務執行に関する監査役会の監査結果の報告を取締役社長および監査法人(会計監査人)に対して行っていますが、内部統制の監査に際しては必要に応じ、内部統制部門より評価等に関する報告を受けています。

また会計監査においては、監査法人(会計監査人)が、監査した結果の報告を取締役社長および監査役に対して行っていますが、内部統制監査については、内部統制部門との間で協議を行っています。

社外取締役および 社外監査役の選任状況

取締役8名のうち、2名が社外取締役です。また監査役4名のうち、3名が社外監査役です。

当社は社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」に定

めるいずれの要件にも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを前提としています。

また独立した立場からの経営の監督または監視という機能および役割が確保されることに加え、人格、見識、経験等の要素を総合的に勘案しています。

社外取締役および社外監査役の選任にあたり 該当しないことを前提とする要件

(東京証券取引所「有価証券上場規程施行規則」より)

- 過去に当社またはその子会社の業務執行者(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下同)であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者を含む。)
- 過去に当社の親会社の業務執行者であった者(業務執行者でない取締役であった者を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役であった者を含む。)
- 過去に当社の兄弟会社の業務執行者であった者
- 過去に当社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者又は当社の主要な取引先の業務執行者であった者
- 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人、組合等の団体であるものに限る。)に過去に所属していた者
- 当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等(業務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。)をいう。以下この章において同じ。)
- aから前fまでに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
- 当社の取引先又はその出身者(業務執行者又は過去10年内のいずれかの時において業務執行者であった者をいう。以下この章において同じ。)
- 当社の出身者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の出身者
- 当社から寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、出身者又はそれに相当する者をいう。以下この章において同じ。)

社外取締役の選任理由

氏名 (就任年月)	選任理由
栗本 弘嗣 (2014年6月)	上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することを期待して選任しています。同氏は、独立した立場からの監督という社外取締役としての機能および役割を十分に果たしていると考えています。なお、栗本氏と当社との間に人的関係、資金的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
関口 典子 (2015年6月)	公認会計士業務を通じて培われた会計における高度な専門性と企業での豊富な実務経験をもとに、複数の上場会社の不正経理に関する外部委員を務めるなど、内部統制にも精通していることから、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することを期待して選任しています。なお、関口氏と当社との間に人的関係、資金的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の選任理由

氏名 (就任年月)	選任理由
新保 誠一 (2013年6月)	金融機関等における豊富な経験と経営者としての幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な視点からの経営監視に寄与することを期待して選任しています。新保氏と当社との間に人的関係、資金的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、新保氏は東京海上日動火災保険株式会社の出身者であり、同社は当社株式を所有しているほか、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での保険に係る取引がありますが、これらの資本関係および取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
米田 克巳 (2013年6月)	金融機関等における豊富な経験と経営者としての幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な視点からの経営監視に寄与することを期待して選任しています。米田氏と当社との間に人的関係、資金的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、米田氏は明治安田生命保険相互会社の出身者であり、同社は当社株式を所有しているほか、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での保険に係る取引がありますが、これらの資本関係および取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
斎藤 広志 (2015年6月)	金融機関等における豊富な経験と他の会社における監査役の経験に加えて、経営者としての幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な視点からの経営監視に寄与することを期待して選任しています。斎藤氏と当社との間に人的関係、資金的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、斎藤氏は三菱UFJ信託銀行株式会社の出身者であり、同社は当社株式を所有しているほか、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での資金の預入、株式事務の委託等に係る取引がありますが、これらの資本関係および取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。また、斎藤氏は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの出身者であり、当社は同社株式を所有していますが、当該資本関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。

社外取締役、社外監査役の主な活動状況

氏名	取締役会、監査役会の出席状況および活動状況
栗本 弘嗣 (社外取締役)	2014年6月26日就任以降開催の取締役会11回の全て(出席率100%)に出席し、主に上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、適宜議案の審議に必要な発言を行いました。
室 幸夫 (社外監査役)	2015年3月開催の取締役会15回の全て(出席率100%)に、また、監査役会15回の全て(出席率100%)にそれぞれ出席し、主に金融機関等における豊富な経験ならびに監査役としての経験と、経営者としての幅広い見識をもとに、適宜意見の表明および質問を行いました。
新保 誠一 (社外監査役)	2015年3月開催の取締役会15回の全て(出席率100%)に、また、監査役会15回の全て(出席率100%)にそれぞれ出席し、主に金融機関等における豊富な経験と経営者としての幅広い見識をもとに、適宜意見の表明および質問を行いました。
米田 克巳 (社外監査役)	2015年3月開催の取締役会15回の全て(出席率100%)に、また、監査役会15回の全て(出席率100%)にそれぞれ出席し、主に金融機関等における豊富な経験と経営者としての幅広い見識をもとに、適宜意見の表明および質問を行いました。

役員の報酬

取締役および監査役の報酬は、業績の拡大により企業価値の向上を図り、株主をはじめとするステークホルダーの皆様のご期待にお応えするとともに、法令等を遵守し経営の健全性を維持することに主眼を置き、以下の要領で定めています。

【取締役の報酬】

基本報酬である定額報酬、単年度の業績連動報酬である賞与および中長期の業績連動報酬であるストックオプション(新株予約権)で構成されています。

定額報酬は、株主総会において承認された報酬枠の範囲内(年額4億20百万円以内)で、取締役会が当社の定める一定の基準に基づいて決定します。

賞与は、上記報酬枠の範囲内(年額4億20百万円以内)で、取締役会が会社および個人の業績等を勘案のうえ、支給の可否、支給額等を決定し、これを支給することとしています。

ストックオプション(新株予約権)は、通常型ストックオプションおよび株式報酬型ストックオプションで構成されています。通常型ストックオプションは、上記報酬枠とは

別枠として2012年6月27日開催の第82回定時株主総会において承認された報酬枠の範囲内(年額42百万円以内)で、取締役会が各取締役に割り当てる新株予約権の個数を決定し、これを付与しています。株式報酬型ストックオプションは、2014年6月26日開催の第84回定時株主総会において承認された報酬体系の見直しに基づき、上記報酬枠の範囲内(年額4億20百万円以内)で、取締役会が当社の定める一定の基準に基づいて決定し、基本報酬の一部から置き換えることにより、株価上昇ならびに長期的な業績および企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に付与しています。なお、社外取締役に役割に鑑みストックオプション(新株予約権)を付与しないこととしています。

【監査役の報酬】

取締役会からの独立性を持って取締役の職務執行の監督、監査を行うという職責に鑑み、基本報酬のみとし、株主総会において承認された報酬枠の範囲内(年額72百万円以内)で、監査役の協議により決定し、これを支給することとしています。

取締役および監査役の報酬等の額(2015年3月期)

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数
		基本報酬	ストックオプション	賞与	
取締役 (社外取締役を除く)	191	154	17	18	6
監査役 (社外監査役を除く)	21	21	—	—	1
社外役員	35	35	—	0	5

(注)

- 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の総額および種類別の総額には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬等を含めていません。
- 取締役(社外取締役を除く)および社外役員の報酬等の総額および種類別の総額には、2014年6月26日開催の第84回定時株主総会(以下、「第84回定時株主総会」といいます。)終結の時を以て退任した社外取締役1名分を含めています。
- 上記のほか、2008年6月26日開催の第78回定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給決議に基づき、第84回定時株主総会終結の時を以て退任した社外取締役1名に対し、退職慰労金を支給しています。なお、当該退職慰労金は、過年度において役員退職慰労引当金繰入額として計上したものです。
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別役員の連結報酬等の総額等を記載していません。



関口 典子

1986年 4月 マニファクチャラーズ・ハノーバー銀行
(現JPモルガン・チェース銀行) 入行
1991年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入所
1994年 3月 公認会計士登録
1998年 2月 日本放送協会入局
2001年12月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社
2002年 1月 公認会計士再登録
2004年 7月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所
2010年11月 関口公認会計士事務所 所長(現)
2011年 4月 独立行政法人国際協力機構 契約監視委員(現)
2011年 7月 独立行政法人国際協力機構 外部審査委員(現)
2012年 7月 税理士登録
2015年 6月 当社取締役(社外取締役)(現)



斎藤 広志

1974年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社
1998年5月 同社資金為替部長
2000年4月 同社資産運用第2部長
2002年5月 同社投資企画部長
2002年6月 同社執行役員投資企画部長
2004年3月 同社執行役員京都支店長
2006年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 代表取締役常務取締役
2007年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表取締役専務取締役
株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役(社外取締役)
2011年6月 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所 代表取締役取締役社長
2012年6月 丸全昭和運輸株式会社 監査役(社外監査役)(現)
2014年6月 株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所 顧問(現)
2015年6月 当社監査役(社外監査役)(現)

新任社外取締役のメッセージ

この度、社外取締役に就任いたしました。流動的かつ不確実性の高い現代においては、取締役会における迅速な意思決定と機動的な業務執行が要求されます。その中で、業務執行と一定の距離を置く社外取締役の役割とは、取締役会における意思決定および取締役の業務執行の監督が主体であると考えています。

私は、公認会計士という独立的・専門的立場での経験を背景に、東京応化工業の社風や文化を理解したうえで、独立した客観的な立場から、自らの識見と一般常識・社会通念に基づき、経営の監督を行い、率直な意見を述べてまいります。そして、経営の健全性・透明性を確保し、透明性を高め、企業価値の向上に資するコーポレート・ガバナンスの充実に努めたいと考えています。

それと同時に、社外取締役としての責務を通じて、東京応化工業におけるより良いコーポレート・ガバナンスの姿とは何かを常に自らに問いかけ、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応えるべく精進してまいります。

新任社外監査役のメッセージ

この度の株主総会で監査役に就任しました斎藤広志です。

企業を取り巻く環境は、グローバル化の進展は言うに及ばず、あらゆる分野で大きく変化してきており、これに併せて企業に期待されるニーズも多様化・複雑化しています。折しも、昨今ではコーポレート・ガバナンスが注目を浴びており、これに対し企業サイドでの実践が求められています。往々にして社外取締役の人数や委員会設置会社であることなど、形式面に注目が集まりがちですが、重要なことは、これを機会に会社のあり方や目指す方向性を整理し、説得力のあるものを作り上げていくための、実践の良き機会と捉えることだと思います。人に個性があるように、企業にもそれぞれ個性があり、その個性に合ったガバナンスを作り上げることが重要で、そのためには自らの頭で考え、自らの言葉で表現・説明し、実践に移していくことが必要になります。「コーポレートガバナンス・コード」にもあるように、今回のチャレンジは、不祥事防止といった後ろ向き面の面のみならず、健全な企業家精神の発揮を実現する土壌の構築という攻めの面でもあることを忘れてはなりません。

社外監査役という任務を遂行するにあたり、社外の目線を意識するとともに、これまで金融機関に約40年間身を置き、マーケット部門、コンプライアンス、財務企画、IR等の職務に従事してきた経験を活かして、より良いコーポレート・ガバナンスの実現、ひいては東京応化工業の持続的成長に貢献していきたいと考えております。

内部統制システム

企業不祥事をはじめ、当社を取り巻く様々なリスクの発生を未然に防止するとともに、経営に及ぼす損害を最小限に食い止めるため、コンプライアンス（法令等遵守）対応、リスク管理対応等をはじめとする内部統制システムの充実に向けて鋭意取り組んでいます。ここではコンプライアンス、リスク管理、情報管理についての取り組みを抜粋してご紹介します。

（内部統制に関する詳細な情報は、「コーポレート・ガバナンス報告書」
http://www.tok.co.jp/content/download/927/11053/file/gov_report.pdf
をご参照）

コンプライアンス体制

【基本方針】

- 「コンプライアンス行動基準」を制定し、役職員が法令、定款、社内規程等を遵守する体制を構築する。
- 取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、法令・行動基準違反等への対応を図る。
- 法令・行動基準違反等の事実の早期発見・解決を図るため、監査役ルートおよび社外ルートを含めた内部通報制度を設けるとともに、当該通報制度利用者が不利益な扱いを受けることのない体制を構築する。
- 取締役の職務執行の適法性を確保するため、当社と利害関係のない社外取締役を置く。
- 財務報告の信頼性を確保するための体制の整備・充実を図る。

【整備状況】

- 事業活動のグローバル化や社会における情勢の変化等を考慮するとともに、適用範囲を重要な海外子会社に拡大するため、「TOKグループ・コンプライアンス行動基準」を改定し、これに基づくコンプライアンス活動の推進に鋭意努めています。また内部通報制度については、社内ルート、監査役ルートおよび社外ルート（顧問弁護士ルート）を設けるとともに、不正な目的で行った場合を除き、通報したことを理由として解雇その他不利益な扱いをしない方針を明確にしています。
- 法令・行動基準違反等の事例が生じた場合は、コンプライアンス委員会において調査・検証を行ったうえで必要

に応じて適切な処分を下すこととしています。併せて、以後同様の事例が生じることのないよう、必要に応じて再発防止策を決定し、社内に周知徹底させることとしています。

- 当社との間で特別の利害関係を有していない社外取締役を2名選任しています（→「社外取締役及び社外監査役の選任状況」ご参照）。
- 財務報告に係る内部統制システムを整備し、運用を行うなど、財務報告の信頼性の確保・向上に鋭意努めています（→「監査役と内部監査部門、会計監査人との連携」ご参照）。

リスク管理体制

【基本方針】

- 「危機管理規程」を制定し、取締役社長を委員長とする危機管理委員会を設置するとともに、その下に危機管理事務局を設置するほか、グループのコンティジェンシープランである業務継続計画を策定し、平時における危機（リスク）の事前予知、予防措置・未然防止策の確立および社内への徹底ならびに緊急事態発生時の迅速・的確な対応を図る。

【整備状況】

- 当社を取り巻く様々なリスクの発生を未然に防止するとともに、経営に及ぼす損害を最小限に食い止めるため、リスク管理対応の強化を図っています。

具体的には、経営に重大な影響を及ぼすリスクに的確に対処することが当社の永続的な発展に不可欠であるとの考えから「危機管理規程」の下に「危機管理マニュアル」「社会リスク」「災害・事故リスク」「製造リスク」および「環境リスク」の各項目において重大な影響を及ぼす結果をもたらすリスクの特定、当該リスクの分析および対策内容の決定、対策の実行ならびに評価等のリスクマネジメントを実施することによって平時の予防措置を講じています。また、万が一各項目におけるリスクが顕在化し、緊急事態が発生した場合には、事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）を含む同マニュアルに従い、迅速かつ的確に対処するための体制を構築しています。

情報管理体制

情報管理は、企業活動を展開していくうえで、「企業価値の向上」および「社会的責任の遂行」という両面から経営上の重要課題となっています。当社グループでは2013年に「情報管理に関する方針」を改定し、これに沿った情報管理体制の強化に向け、情報管理委員会を通じて、経営層をはじめ全従業員が組織的に取り組んでいます。

【基本方針】

①情報資産の定義・保護・有効活用

当社グループが保有する経営情報、顧客・営業情報、個人情報および技術情報など、全ての情報資産について、情報セキュリティに関する法令、その他の社会的規範および社内規程などを遵守し、適切にそれを保護するとともに業務を効率的に遂行するために、定められた権限内において、かつ所期の目的のためにのみ使用する。

②組織体制・組織的活動

「情報管理委員会」を設け、グループ全体で情報資産の管理体制を構築・維持・推進する。

③完全性・機密性・可用性

保有する情報資産の漏洩、改ざん、盗難、破壊等を防止するため、人的、物理的、組織的およびITによる諸施策を通じて適切に管理する。

IR活動

経営の透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、会社情報の適時開示や各種IRツールの提供を積極的に行っています。

活動	内容
アナリスト・機関投資家向け説明会	年2回、決算説明会を開催 取締役社長が説明者として、決算の概要、業績見通し、今後の方針等を説明
個人投資家向け説明会	個人投資家向け説明会を開催 2015年3月期実績：計8回（東京・大阪 各2回、名古屋・福岡・広島・神戸 各1回）
IR資料のホームページ掲載	決算説明会資料（説明会の動画を含む）、会社案内ビデオ、コーポレート・ガバナンス関連情報、株主総会関連情報、株式関連情報、財務データ、その他IRツール（アニュアルレポート、報告書、有価証券報告書（四半期報告書）、CSRレポート等）

④教育

社内教育を定期的かつ継続的に実施し、意識の向上と社内規程などの周知徹底を図る。

⑤インシデント対応

情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、その被害を最小限にとどめるよう努めるとともに、再発防止策を実施する。

⑥監査・継続的改善

情報資産の管理の一環として、定期的に監査を実施し、継続的に改善を進める。

【整備状況】

- 情報資産の適切な保護・管理
- 人的・物理的・組織的およびITによる情報セキュリティ運営体制の拡充
- 啓もう・教育活動
- 情報流出が起こった場合、被害を最小限とする対応
- 監査体制の確立等



「攻め」と「守り」の環境経営で、企業価値の向上へ

東京応化は、社会全体のニーズを視野に入れた独自性の高い企業活動や全てのステークホルダーとの協働によって社会的価値を創造しつつ、企業価値を向上させていくことをCSRの基本的姿勢としています。特に環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応は、エレクトロニクス産業向けの先端フォトレジストの開発・製造と密接であるだけでなく、重要なリスク管理の一部でもあると認識し、「攻め」と「守り」の両面から、環境経営に注力しています。

東京応化ならではの社会的価値を創造し、持続可能な社会に貢献

当社のCSR活動および環境経営の詳細については、WEBサイト「CSR情報」および「CSRレポート2015」をご参照ください。



<http://www.tok.co.jp/csr>

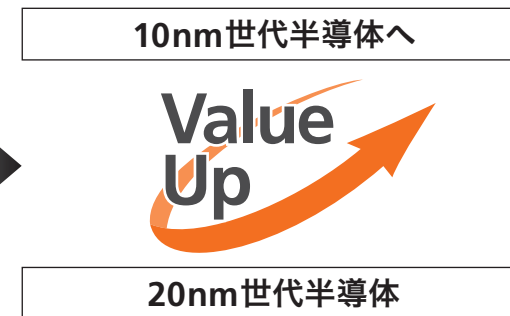
「攻め」の環境経営

tok フォトレジストの進化による提供価値の最大化

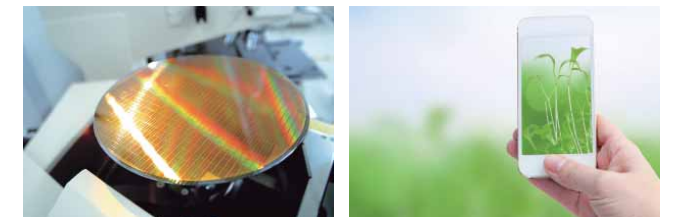
東京応化が独自性を最も発揮でき、東京応化にしか生み出せない社会的価値の源泉：「世界最高水準のフォトレジスト」



顧客 半導体デバイスの回路素子寸法が1/2になれば、消費電力は1/4に*



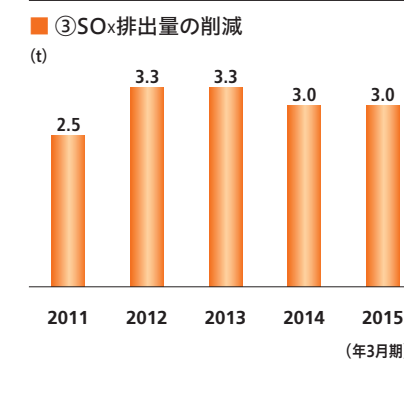
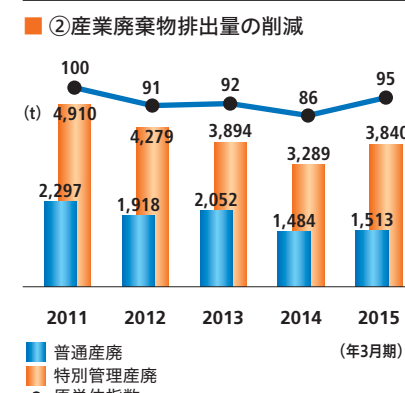
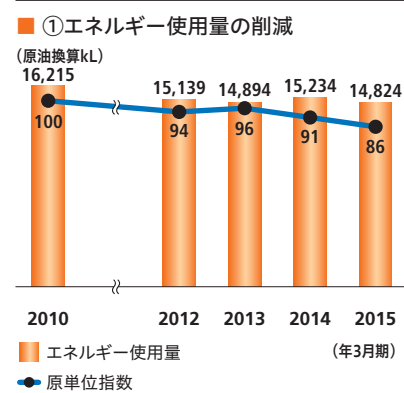
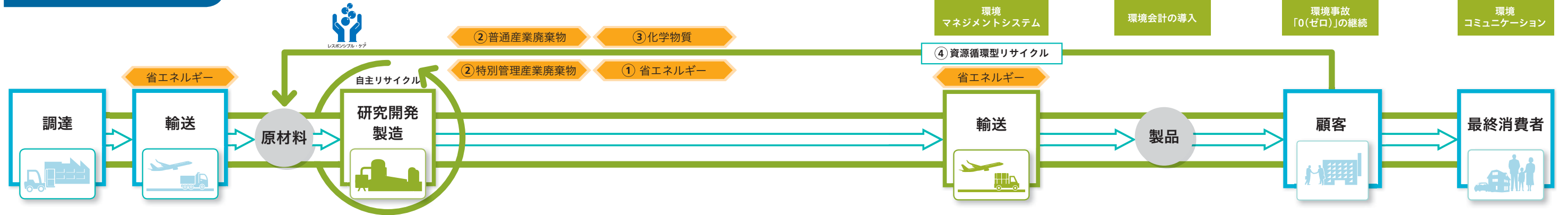
「半導体のさらなる微細化」「製品のさらなる省エネルギー化」を実現



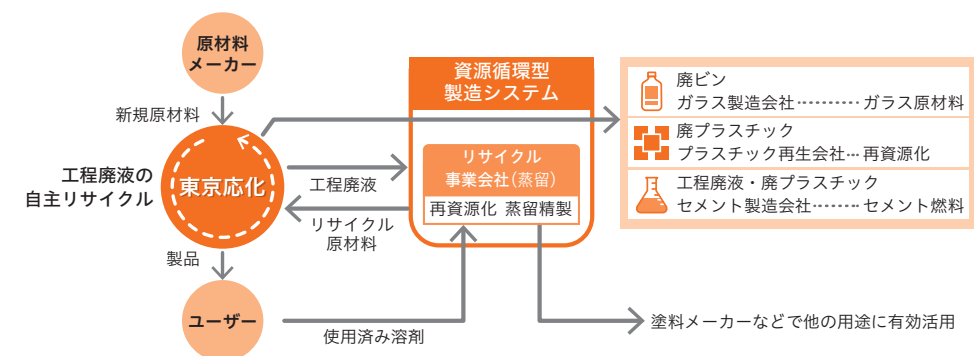
*スケールアップに準じた場合

「守り」の環境経営

レスポンスブル・ケア



④ 使用済み溶剤および工程廃液の再資源化



取締役、監査役および執行役員

取締役



- | | | | | |
|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| (後列左より) | 徳竹 信生
取締役兼執行役員
材料事業本部長 | 栗本 弘嗣
社外取締役
(オイレス工業株式会社
相談役) | 関口 典子
社外取締役
(関口公認会計士事務所
所長) | 水木 國雄
取締役兼執行役員
総務本部長 |
| (前列左より) | 駒野 博司
取締役兼執行役員
新事業開発室長 | 阿久津 郁夫
代表取締役取締役社長
兼執行役員社長 | 岩崎 光文
取締役兼専務執行役員
営業本部長 | 佐藤 晴俊
取締役兼執行役員
開発本部長 |

監査役



- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 米田 克巳
社外監査役 | 新保 誠一
社外監査役 | 田澤 賢二
常勤監査役 | 斎藤 広志
社外監査役 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

執行役員

- | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 柴村 洋一
常務執行役員
経理本部長 | 萩原 嘉男
常務執行役員
経営企画室長 | 柴垣 篤郎
執行役員
営業本部副本部長 | 藤下 一
執行役員
プロセス機器事業本部長 | 張 俊
執行役員
TOK先端材料株式会社
代表理事副社長 |
| 山田 敬一
執行役員
営業本部副本部長 | 佐藤 和史
執行役員
開発本部副本部長 | 入野 浩一
執行役員
台湾東應化股份有限公司
董事長兼総経理 | 村上 裕一
執行役員
材料事業本部副本部長 | 種市 順昭
執行役員
新事業開発室副室長 |

経理本部長メッセージ

“資本効率向上への取り組みを
本格化するステージへ”

常務執行役員 経理本部長
柴村 洋一

ROE向上への取り組みを本格化

2015年3月期における当社のROEは、6.2%となりました。当社は、これまでROE目標数値を公表していませんでしたが、2016年5月に発表予定の次期中期計画(2017年3月期~2019年3月期)では、目標数値を設定したうえで、ROE向上への取り組みを本格化する見込みです。現在、事業戦略、資本戦略の策定と並行し、目標数値を精査中です。

ROE目標数値の公表を検討している背景には、当社の業績モメンタムが大きく変わってきた点があります。リーマンショック直後の2009年3月期に上場以来初となる営業赤字を計上して以降、当社は事業の選択と経営資源の集中の観点より、一部国内工場の閉鎖、海外子会社や印刷材料事業の譲渡等、様々な事業構造改革を進めてまいりました。同時に、成長分野での事業基盤の確立、売上高の確保、事業機会の創出を最優先し、「営業利益」絶対額の拡大を優先目標に掲げ、半導体向け最先端材料分野の強化・拡大、海外における顧客密着戦略の強化、装置事業でのターゲット領域の転換など、事業ポートフォリオの抜本的再構築に全力を注いできました。

その間、資本効率の重要性は十分認識しておりましたが、目の前の喫緊の課題として、長期的な成長の核となり得る事業ポートフォリオの構築、つまり「明日の飯の種を生むフィールド(事業基盤)を如何に確保するか」について、まず最優先で取り組んできた次第です。

その結果、2015年3月期は過去最高の営業利益を更新し、今後は成長戦略への取り組みをさらに加速し、「質の高

い利益」を追求するステージに移行できたと認識しています。営業利益は引き続き最重要指標ではあるものの、ROE等資本効率向上への取り組みも本格化させていきます。

「質の高い利益」の追求

目標数値の設定へ向け、現在、ROEを3分解した各指標(売上高当期純利益率、総資産回転率、財務レバレッジ)の見直しを進めています。

2015年3月期の営業利益率は15%と化学セクター内でも比較的高水準にあるものの、「質の高い利益」をさらに追求することで、上昇余地はまだあると認識しています。既存事業では、半導体関連材料を中心に最先端フォトレジストや高密度実装材料といった高付加価値分野への注力度を高めることで、利益の質はさらに高まると考えています。新規事業創出においては、技術開発者の熱意や柔軟な発想を大切にしながらも、市場性や事業性を厳しくチェックし、出口を明確にイメージできるものを育成していきます。これらを通じて「質の高い利益」を追求していくことが、ROE向上策に対する分子政策の方向性となると考えています。

強固な財務基盤を重視する理由

2015年3月期末の自己資本比率は84.3%、D/Eレシオは0.01以下と、化学セクターでトップクラスの財務健全性を有しています。

強固な財務基盤を重視してきた最大の理由は、当社が、

半導体最先端領域をはじめとする「ニッチで、かつ極めて技術転換が激しく、また転換スピードの速い事業領域」を主なマーケットとする「研究開発型企業」であるためです。主力製品のほとんどが、新規開発品または新事業領域のニッチ製品であり、様々なグローバルニッチ分野において、各種開発品の上市を繰り返しニッチトップを確保し続けるビジネスモデルに立脚するため、相応のキャッシュリザーブが必要となります。

もう一つの理由として、特殊な競争環境があげられます。競合の多くは当社より企業規模が大きく、バルクケミカル品など量産型の既存領域を擁しながら、並行して最先端領域を開発・開拓しています。当社と異なる企業規模やキャッシュ創出構造を有する企業と対等に競争していくうえでは、投資の質はもとより、投資規模、投資スピード等の面でもライバルを凌駕していく必要があります、やはり相応のキャッシュリザーブが欠かせません。

事業投資にあたっては、対象マーケットの成長性、当社コア技術の使用可能性や優位性、予想キャッシュ・フロー等を総合的に勘案しつつ、スピーディな判断を心掛けています。しかしながら半導体の最先端領域や、技術ロードマップが存在しない新規事業領域においては、研究開発、技術開発に積極的に取り組むとしても、その困難さや不確実性は確実に高まっています。また、高密度実装材料のように長年の投資の末に開花したテクノロジーもあり、事業の種を長期スパンで育成することも必要とされます。

今後もエレクトロニクス業界で培った知見をベースに事業リスク等の最小化に努めますが、最終的には何らかのリスクテイクが必要であり、これをなくして、当社のような「研究開発型企業」の持続的発展はありえません。

従って、不確実性の高い事業投資においてもリスクテイクできる財務基盤、また、仮に成功しなくても他の投資計画や研究開発計画に影響を与えないような強固な財務基盤は今後も必要であり、次期中期計画においても、相応のキャッシュリザーブを行う方針は継続します。

一方、業績面では新たなステージでのチャレンジ段階に入ったことから、資本効率の重要性がますます高まることも強く認識しています。強固な財務基盤は維持しつつも、事業の状況を見ながら、投資基準のさらなる明確化や、D/Eレシオの見直し等を行う可能性は大いにあると考えています。

■ 成長投資と株主還元のバランスを重視

株主還元方針としては、2014年3月期より新たに「連結配当性向30%以上の継続的实施」を掲げています。また、7期ぶりに実施した自社株買いについては、長期的見地から、今後も弾力的に実施していく方針ですが、次期中期計画では、これらを基本線としつつも、企業価値向上のための資本政策の適正な方針等をさらに明確化したいと考えています。大事なことは、まずは「ゴーイングコンサーンとして、成長し続ける企業であり続けること」です。そのうえで、「成長のための事業投資と株主還元のバランス」を重視しながら資本政策を立案してまいります。また「質の高い利益規模の拡大」に加えて、「適切な資本政策」を実行することは、シグナリング効果やWACCの引き下げをもたらす、補完的ではあるものの、企業価値増大の重要手段の一つとなると考えております。

いずれにしても、今後も、「事業投資と株主還元」を重視して、株主の皆様の期待に応えていきたいと考えています。

経理本部長による財政状態および経営成績の分析



上原価率は、前期比0.8ポイント上昇の62.6%となりました。これにより、売上総利益は、前期比42億65百万円(14.9%)増加の329億84百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、特許等使用料や業務委託費等の減少等はありませんでしたが、減価償却費や水道光熱費等の増加により、前期比10億38百万円(5.6%)増加の197億31百万円となりました。

営業利益は、販売費及び一般管理費は増加したものの、売上総利益の増加により、前期比32億27百万円(32.2%)増加し、過去最高益である132億53百万円となりました。

税金等調整前当期純利益、当期純利益

税金等調整前当期純利益は、新工場関連費用やデリバティブ評価損の増加等はありませんでしたが、為替差益や退職給付制度改定益の増加等から、前期比26億35百万円(22.6%)増加の143億1百万円となりました。

当期純利益は、前期比12億69百万円(16.8%)増加の88億18百万円となり、過去最高益となりました。

〈業績の概況〉

売上高

当期(2015年3月期)の連結売上高は、前期比128億17百万円(17.0%)増加の880億86百万円となりました。このうち、上期の売上高は、前年同期比29億85百万円(7.6%)増加の420億57百万円、下期の売上高は、前年同期比98億31百万円(27.2%)増加の460億29百万円となりました。

当社製品の主な需要先であるエレクトロニクス業界においては、パソコン需要の落ち込みが和らいだことに加え、スマートフォンやタブレット端末等の需要は引き続き拡大したことから、総じて堅調に推移しました。

売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益

当期の売上原価は、売上増加による材料費の増加に加え、減価償却費や修繕費等が増加したことから、前期比85億51百万円(18.4%)増加の551億1百万円となり、売

〈セグメント別の概況〉

※セグメント間の取引は、相殺消去していません。

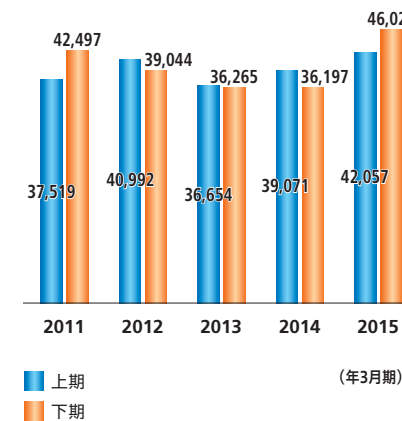
事業の種類別セグメント情報

【材料事業】

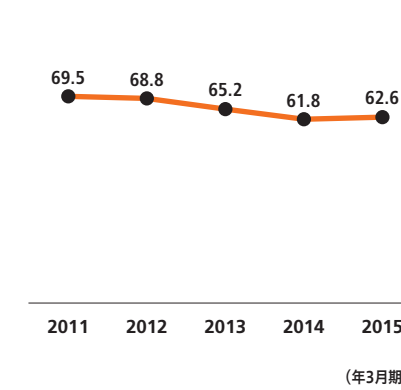
当期における材料事業の売上高は、前期比117億44百万円(16.1%)増加の846億11百万円となりました。なお、利益面では、高付加価値製品の売上増加や為替変動



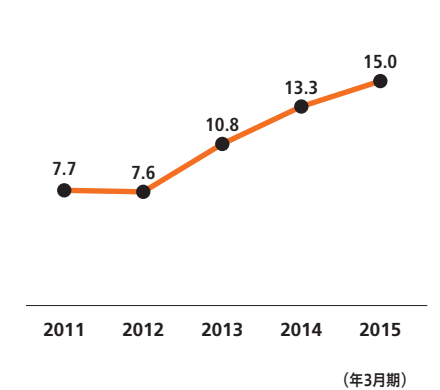
■ 売上高(半期別)
(百万円)



■ 売上原価率
(%)



■ 営業利益率
(%)



により、営業利益は前期比22億69百万円(16.1%)増加の163億55百万円となりました。

エレクトロニクス機能材料部門

エレクトロニクス機能材料部門の売上高は、前期比65億56百万円(15.2%)増加の498億18百万円となりました。

半導体用フォトレジストは、スマートフォンやタブレット端末等の需要拡大に加え、車載向けや産業用電子機器向けなど、半導体搭載製品の市場拡大を背景として、売上は好調に推移いたしました。一方、液晶ディスプレイ用フォトレジストでは、高精細ディスプレイ向け製品および汎用製品ともに、ユーザー需要環境の変化や製品価格下落の影響を受け、売上は減少いたしました。また、高密度実装材料は、アジア、北米地域を中心とした営業活動が奏功し、半導体パッケージ用フォトレジストおよびMEMS(微小電気機械システム)用フォトレジストの販売が増加したことから、売上を大きく伸ばすことができました。

高純度化学薬品部門

高純度化学薬品部門の売上高は、前期比56億50百万円(19.4%)増加の348億44百万円となりました。

半導体用フォトレジスト付属薬品は、ユーザーニーズに対応した高品質な製品が、好調な半導体市場の需要拡大を捉え、アジア地域を中心に売上は大きく増加いたしました。また、液晶テレビの需要が回復基調にあり、液晶ディ

スプレイ用フォトレジスト付属薬品も、アジア地域を中心に販売が堅調に推移し、売上は増加いたしました。

【装置事業】

プロセス機器部門

シリコン貫通電極形成システム「Zero Newton®」は、3次元実装市場の立上がり遅延や出荷済み製品の検収遅延等の影響を受けたものの、ユーザーニーズを的確に捉え、高い評価を得ている独自プロセス技術の優位性維持に努めるとともに、組織改編による販売力の強化や原価低減を推し進めるなど、競争力の強化に取り組んだ結果、受注・売上ともに増加いたしました。一方、液晶パネル製造装置は、受注低迷の影響を受け、売上が減少いたしました。

この結果、装置事業の売上高は、前期比10億96百万円(44.2%)増加の35億81百万円となりました。また、営業利益は20百万円(前期は営業損失8億89百万円)となりました。

なお、受注高は、前期比15億94百万円(83.7%)増加の35億円となりました。このうち、上期の受注高は16億29百万円、下期の受注高は18億70百万円となりました。また、期末時点での受注残高は、前期末比21百万円(2.0%)増加の10億72百万円となりました。

〈財政状態およびキャッシュ・フロー〉

財政状態

当期末(2015年3月31日)の資産合計は、前期末比190億4百万円増加の1,748億63百万円となりました。

流動資産は、前期末比78億6百万円増加し、910億54百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が27億98百万円、譲渡性預金の取得により有価証券が20億円、たな卸資産が11億9百万円、現金及び預金が5億95百万円増加したことが主な要因です。

固定資産は、前期末比111億98百万円増加し、838億9百万円となりました。これは繰延税金資産が3億63百万円、長期貸付金が3億22百万円減少したものの、設備投資により有形固定資産が47億94百万円、投資有価証券の購入および時価上昇等により投資有価証券が43億46百万円、退職給付に係る資産が20億67百万円、無形固定資産が2億84百万円増加したことが主な要因です。

当期末の負債合計は、前期末比69億68百万円増加の228億64百万円となりました。これは前受金が6億92百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が40億53百万円、未払金が3億42百万円、未払費用の増加等により流動負債のその他が6億12百万円増加し、固定負債の繰延税金負債が10億2百万円、長期未払金の増加等により固定負債のその他が7億4百万円増加したことが主な要因です。

当期末の純資産合計は、前期末比120億36百万円増加の1,519億99百万円となりました。これは配当金の支払

26億10百万円があったものの、当期純利益88億18百万円の確保や、為替換算調整勘定が28億77百万円、その他有価証券評価差額金が14億71百万円増加したことが主な要因です。

この結果、当期末の自己資本比率は84.3%となりました。

キャッシュ・フロー

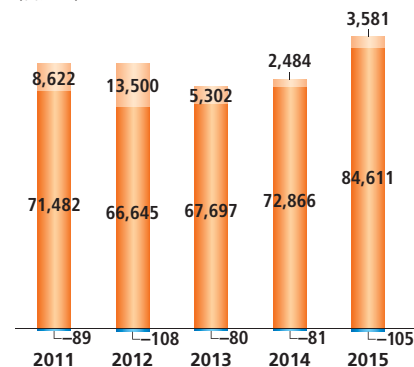
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加や、退職給付に係る資産の増加、法人税等の支払いがありましたものの、税金等調整前当期純利益の増加、仕入債務の増加等により、前期に比べ16億96百万円増加の135億77百万円の資金収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入がありましたものの、有形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取得による支出等により、前期に比べ42億94百万円減少の101億97百万円の資金投下となりました。

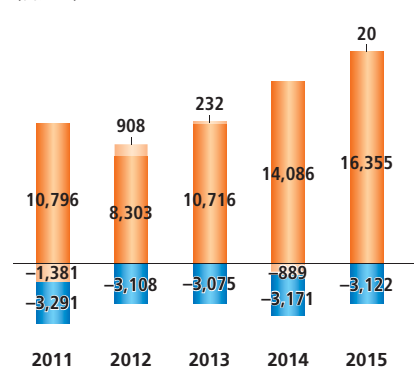
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入や自己株式の売却による収入がありましたものの、配当金の支払等により、前期に比べ3億61百万円減少の21億10百万円の資金支出となりました。

これらの活動の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末の391億57百万円から24億8百万円増加し415億65百万円となりました。

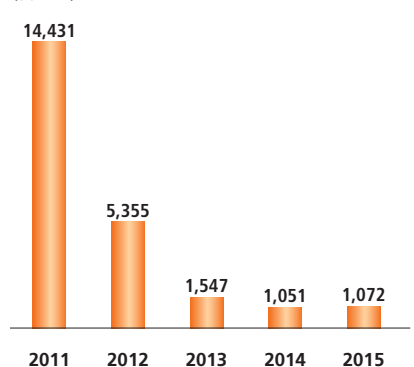
■ セグメント別売上高 (百万円)



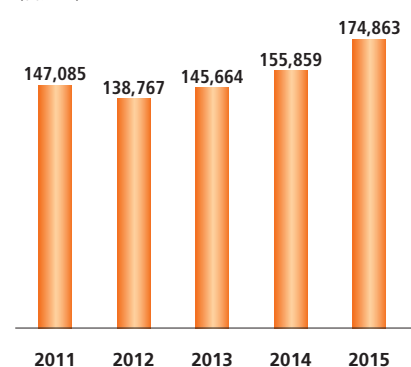
■ セグメント損益 (百万円)



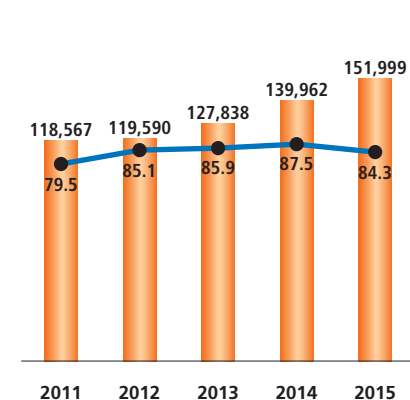
■ 装置事業の受注残高 (百万円)



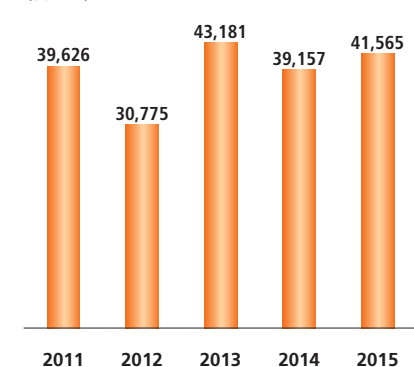
■ 総資産 (百万円)



■ 純資産/自己資本比率



■ 現金及び現金同等物 (百万円)

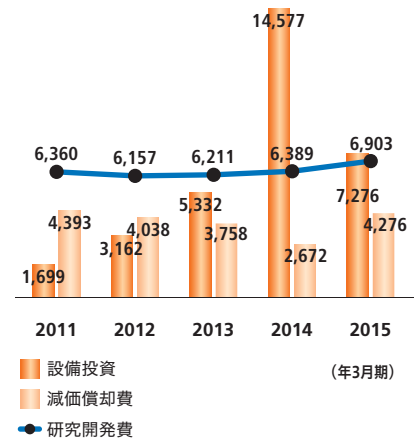


2016年3月期の見通し

2016年3月期の売上高は、エレクトロニクス機能材料の拡大が増収を牽引し、装置事業の増収も見込まれることから、前期比9.8%増の967億円を予想しています。営業利益については、韓国のTOK尖端材料株式会社を中心とする減価償却費の増加はあるものの前期比0.4%増の133億円、当期純利益は、為替差益、税金費用の減少を見込み、前期比2.1%増の90億円を予想しています。

なお為替相場は、前期の期中平均109.3円に対し、同115.0円/米ドルを想定しています。

■ 設備投資・減価償却費・研究開発費
(百万円)



事業等のリスク

当社グループは、幅広い事業分野にわたり世界各地で活動しております。その事業活動を展開するうえで、多様なリスク要因が財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。以下に記載したリスクは、2015年3月31日現在において当社グループが判断したものであり、当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではありません。

(1) 業界景気変動リスク

当社グループが事業を展開するエレクトロニクス業界は、循環的な市況変動が大きい市場であります。特に半導体・液晶ディスプレイ向け材料・装置は、需要動向に大きな影響を受け、また、技術革新が速くユーザーニーズが複雑・多様にわたるため、市場状況およびそれに連動した価格変動があった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

業績予想

(百万円、%)

	2015実績	2016予想	
		増減	増減率
売上高	88,086	96,700	+8,613 +9.8
営業利益	13,253	13,300	+46 +0.4
当期純利益	8,818	9,000	+181 +2.1

(年3月期)

(2) 為替変動リスク

当社グループは、今後もマーケットの拡大が期待される北米、欧州、アジア地域における事業に注力しており、同地域に生産・販売拠点を有しております。海外取引では、一部は円建てでの処理、また、一部では為替予約によるリスクヘッジ等を行っておりますが、予想を超えた為替相場の変動があった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3) 研究開発リスク

当社グループは、技術革新の激しいエレクトロニクス業界において競争力を維持するため、ユーザーニーズを的確に捉えた製品の研究開発に努めております。しかし、技術革新やユーザーニーズの変化を予測することは容易でなく、研究開発において経営資源を投入したにもかかわらず、予期せぬ理由で十分な成果が得られない場合があり、その結果、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(4) 知的財産リスク

当社グループは、事業活動を展開するうえで多数の知的財産権を保有しているとともにライセンスを供与しております。また、必要または有効と認められる場合には、第三者の知的財産権を使用するために相手方からライセンスを取得します。それらの権利保護、維持または取得が予定通り行われなかった場合には、知的財産権を巡る紛争・訴訟において当社グループが当事者となる可能性があります。その結果、費用負担等が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(5) 原材料調達リスク

当社グループは、生産活動において様々な原材料を使用しており、調達先を複数確保するなど安定的な原材料の調達に努めております。しかし、原材料メーカーの事故等による供給の遅延・中断の影響から生産活動に支障をきたす可能性があり、その結果、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、原材料価格の上昇等が発生した場合も、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(6) 製造物責任リスク

当社グループの提供する製品をユーザーが使用する過程において、その製品に起因する欠陥により不具合が生じる可能性があります。製造物責任賠償には保険での対応を行いますが、負担金額全てを保険でカバーできるという保証はなく、これらの問題が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(7) 自然災害・事故リスク

当社グループは、国内外に製造工場を設けております。地震等の自然災害や火災・爆発等の不慮の事故が発生した場合には、生産活動の停止に伴う出荷の遅延、さらには修復・生産工場等の代替に伴う費用負担が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(8) 環境リスク

当社グループは、生産活動において各種化学物質を使用しており、その取扱いには万全の対策を講じております。しかし、化学物質の社外流出事故が万一発生した場合、社会的信用の失墜、補償・対策費用の支出、生産活動の停止等により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

また、当社グループは、事業展開している世界各国の環境関連諸法令・諸規制を遵守して活動しております。しかし、将来においてこれらの法規制が厳格化された場合、費用負担の増大、事業活動の制限につながるおそれがあり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(9) 法的リスク

当社グループは、事業活動を展開する世界各国において、事業・投資の許可、輸出入制限での政府規制の適用を受けるとともに、通商・独占禁止・国際税務・環境・リサイクル関連等の諸法令・諸規制の適用を受けております。これらの法規制に重大な変更があり、その内容を把握していなかった場合、また、これらの法規制を遵守できなかった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(10) 海外での事業活動リスク

当社グループは、北米、アジア地域にて生産および販売活動を、また、欧州地域にて販売活動を行っております。しかし、海外での事業活動には、通常、予期しない法律や規制の変更、産業基盤の脆弱性、人材の確保困難、テロ・戦争、自然災害等のリスクが存在します。こうしたリスクが顕在化した場合、海外での事業活動に支障が生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(11) 情報漏洩リスク

当社グループは、事業に関する秘密情報ならびに多数の他企業および個人の情報を有しております。情報管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事態によりこれらの情報が社外に流出した場合、事業のイメージに悪影響をもたらすほか、被害を受けた企業および個人に対して損害賠償責任を負うことになり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

連結貸借対照表

東京応化工業株式会社および連結子会社
2014年および2015年3月31日現在

資産の部	百万円		千米ドル
	2015	2014	2015
流動資産			
現金及び現金同等物	¥ 39,565	¥ 39,157	\$ 329,716
定期預金	14,401	14,213	120,010
債権			
受取手形及び売掛金	19,422	16,623	161,850
有価証券	2,000	—	16,666
その他	1,089	526	9,079
貸倒引当金	(35)	(154)	(292)
たな卸資産	11,555	10,446	96,296
繰延税金資産	1,821	1,563	15,182
前払費用及びその他の流動資産	1,232	871	10,274
流動資産合計	91,054	83,247	758,783
固定資産			
土地	9,205	9,014	76,716
建物及び構築物	55,881	52,936	465,679
機械装置及び運搬具	55,382	42,519	461,522
工具、器具及び備品	16,531	15,687	137,765
リース資産	0	—	4
建設仮勘定	5,420	13,892	45,172
小計	142,423	134,049	1,186,860
減価償却累計額	(93,051)	(89,472)	(775,431)
有形固定資産合計	49,371	44,577	411,429
投資その他の資産			
投資有価証券	10,808	6,635	90,069
非連結子会社および関連会社への投資	789	920	6,576
退職給付に係る資産	2,964	896	24,701
長期預金	18,000	18,000	150,000
繰延税金資産	60	424	507
その他	1,815	1,157	15,126
投資その他の資産合計	34,437	28,034	286,981
資産合計	¥174,863	¥155,859	\$1,457,194

負債・純資産の部	百万円		千米ドル
	2015	2014	2015
流動負債			
債務			
支払手形及び買掛金	¥ 9,797	¥ 5,744	\$ 81,648
建設その他	3,051	2,600	25,428
未払法人税等	2,176	1,988	18,135
未払費用	3,633	3,018	30,280
前受金	14	706	120
繰延税金負債	40	4	336
その他	581	314	4,844
流動負債合計	19,295	14,377	160,793
固定負債			
長期借入金	549	244	4,579
役員退職慰労引当金	7	8	61
繰延税金負債	2,036	1,034	16,972
退職給付に係る負債	134	93	1,119
その他	841	138	7,009
固定負債合計	3,569	1,518	29,742
株主資本			
資本金 普通株式—発行可能株式総数197,000,000株； 発行済株式総数46,600,000株	14,640	14,640	122,003
資本剰余金	15,207	15,207	126,732
利益剰余金	109,500	103,162	912,506
自己株式—1,598,326株 2015年3月期 1,597,486株 2014年3月期	(3,183)	(3,280)	(26,529)
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金	3,877	2,406	32,311
為替換算調整勘定	5,813	2,936	48,449
退職給付に係る調整累計額	1,590	1,380	13,255
小計	147,447	136,453	1,228,729
新株予約権	191	83	1,593
少数株主持分	4,360	3,425	36,335
純資産合計	151,999	139,962	1,266,658
負債純資産合計	¥174,863	¥155,859	\$1,457,194

連結損益計算書

東京応化工業株式会社および連結子会社
2014年および2015年3月31日終了事業年度

	百万円		千米ドル
	2015	2014	2015
売上高	¥88,086	¥75,269	\$734,055
売上原価	55,101	46,550	459,181
売上総利益	32,984	28,718	274,873
販売費及び一般管理費	19,731	18,693	164,431
営業利益	13,253	10,025	110,442
営業外収益			
受取利息及び受取配当金	229	309	1,913
為替差益	1,459	1,391	12,160
受取保険金及び配当金	85	279	709
デリバティブ評価損	(460)	—	(3,835)
新工場関連費用	(496)	—	(4,140)
減損損失	(665)	(856)	(5,545)
退職給付制度改定益	622	—	5,189
その他	274	516	2,286
その他収益(費用)	1,048	1,640	8,737
税金等調整前当期純利益	14,301	11,666	119,180
法人税、住民税及び事業税			
当年度	4,161	3,148	34,680
過年度	40	75	334
繰延	663	333	5,532
法人税等合計	4,865	3,557	40,547
少数株主損益調整前当期純利益	9,435	8,108	78,632
少数株主利益	(617)	(559)	(5,144)
当期純利益	¥ 8,818	¥ 7,549	\$ 73,487

	円		ドル
	2015	2014	2015
基本1株当たり当期純利益	¥196.61	¥168.54	\$1.63
希薄化後基本1株当たり当期純利益	195.71	168.41	1.63
年間配当金	60.00	52.00	0.50

連結包括利益計算書

東京応化工業株式会社および連結子会社
2014年および2015年3月31日終了事業年度

	百万円		千米ドル
	2015	2014	2015
少数株主損益調整前当期純利益	¥ 9,435	¥ 8,108	\$ 78,632
その他の包括利益			
その他有価証券評価差額金	1,471	288	12,259
為替換算調整勘定	3,168	4,544	26,400
退職給付に係る調整額	210	—	1,752
持分法適用会社に対する持分相当額	72	107	601
その他の包括利益合計	4,921	4,941	41,013
包括利益	¥14,357	¥13,050	\$119,645
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	¥13,377	¥11,943	\$111,476
少数株主に係る包括利益	980	1,106	8,169

連結株主資本等変動計算書

東京応化工業株式会社および連結子会社
2014年および2015年3月31日終了事業年度

	千株	百万円										
	発行済株式数	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他の有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	小計	新株予約権	少数株主持分	純資産合計
2013年4月1日残高	44,762	¥14,640	¥15,207	¥ 97,773	¥(3,398)	¥2,117	¥(1,168)	¥ —	¥125,172	¥ 17	¥2,649	¥127,838
当期純利益	—	—	—	7,549	—	—	—	—	7,549	—	—	7,549
剰余金の配当												
前期末: 24円	—	—	—	(1,080)	—	—	—	—	(1,080)	—	—	(1,080)
第2四半期末: 24円	—	—	—	(1,080)	—	—	—	—	(1,080)	—	—	(1,080)
自己株式の取得	(0)	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	—	—	(1)
自己株式の処分	62	—	—	—	120	—	—	—	120	—	—	120
株主資本以外の項目の当期変動額	—	—	—	—	—	288	4,104	1,380	5,774	65	776	6,616
前期末残高	44,823	14,640	15,207	103,162	(3,280)	2,406	2,936	1,380	136,453	83	3,425	139,962
会計方針の変更による累積的影響額				129					129			129
会計方針の変更を反映した当期首残高	44,823	14,640	15,207	103,292	(3,280)	2,406	2,936	1,380	136,583	83	3,425	140,092
当期純利益	—	—	—	8,818	—	—	—	—	8,818	—	—	8,818
剰余金の配当												
前期末: 28円	—	—	—	(1,260)	—	—	—	—	(1,260)	—	—	(1,260)
第2四半期末: 30円	—	—	—	(1,350)	—	—	—	—	(1,350)	—	—	(1,350)
自己株式の取得	(0)	—	—	—	(2)	—	—	—	(2)	—	—	(2)
自己株式の処分	51	—	—	—	99	—	—	—	99	—	—	99
株主資本以外の項目の当期変動額	—	—	—	—	—	1,471	2,877	210	4,558	108	934	5,601
当期末残高	44,873	¥14,640	¥15,207	¥109,500	¥(3,183)	¥3,877	¥5,813	¥1,590	¥147,447	¥191	¥4,360	¥151,999

	千米ドル										
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他の有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	小計	新株予約権	少数株主持分	純資産合計
前期末残高	\$122,003	\$126,732	\$859,687	\$(27,335)	\$20,052	\$24,472	\$11,502	\$1,137,115	\$ 693	\$28,548	\$1,166,357
会計方針の変更による累積的影響額			1,083					1,083			1,083
会計方針の変更を反映した当期首残高	122,003	126,732	860,770	(27,335)	20,052	24,472	11,502	1,138,198	693	28,548	1,167,440
当期純利益	—	—	73,487	—	—	—	—	73,487	—	—	73,487
剰余金の配当											
前期末: 0.23米ドル	—	—	(10,500)	—	—	—	—	(10,500)	—	—	(10,500)
第2四半期末: 0.25米ドル	—	—	(11,250)	—	—	—	—	(11,250)	—	—	(11,250)
自己株式の取得	—	—	—	(22)	—	—	—	(22)	—	—	(22)
自己株式の処分	—	—	—	827	—	—	—	827	—	—	827
株主資本以外の項目の当期変動額	—	—	—	—	12,259	23,976	1,752	37,988	900	7,787	46,676
当期末残高	\$122,003	\$126,732	\$912,506	\$(26,529)	\$32,311	\$48,449	\$13,255	\$1,228,729	\$1,593	\$36,335	\$1,266,658

連結キャッシュ・フロー計算書

東京応化工業株式会社および連結子会社
2014年および2015年3月31日終了事業年度

	百万円		千米ドル
	2015	2014	2015
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	¥14,301	¥11,666	\$ 119,180
調整:			
法人税等の支払額又は還付額(支払)	(3,935)	(2,583)	(32,796)
減価償却費	4,276	2,672	35,641
貸倒引当金の増減額(減少)	(94)	(925)	(785)
為替差損益(益)	(1,423)	(970)	(11,858)
減損損失	665	856	5,545
デリバティブ評価損益(益)	460	—	3,835
退職給付に係る資産の増減額(増加)	(1,855)	(297)	(15,462)
退職給付に係る負債の増減額(減少)	39	21	330
売上債権の増減額(増加)	(2,119)	720	(17,658)
たな卸資産の増減額(増加)	(368)	1,018	(3,073)
仕入債務の増減額(減少)	3,121	(449)	26,009
前受金の増減額(減少)	(692)	(652)	(5,768)
その他	1,200	804	10,008
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,577	11,881	113,148
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の純増減額(増加)	(70)	(157)	(585)
有形固定資産の取得による支出	(7,052)	(14,616)	(58,770)
無形固定資産の取得による支出	(456)	(424)	(3,803)
長期預金の預入による支出	(13,000)	(13,000)	(108,333)
長期預金の払戻による収入	13,000	13,000	108,333
投資有価証券の取得による支出	(2,284)	—	(19,039)
投資有価証券の売却による収入	—	382	—
その他	(333)	323	(2,779)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(10,197)	(14,491)	(84,977)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入れによる収入	523	—	4,362
長期借入金の返済による支出	(122)	(122)	(1,016)
配当金の支払額	(2,605)	(2,155)	(21,712)
少数株主への配当金の支払額	(45)	(330)	(382)
自己株式の売却による収入	148	133	1,239
自己株式の取得による支出	(2)	(1)	(22)
その他	(6)	4	(57)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(2,110)	(2,471)	(17,589)
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,138	1,058	9,487
現金及び現金同等物の増減額(減少)	2,408	(4,023)	20,069
現金及び現金同等物の期首残高	39,157	43,181	326,313
現金及び現金同等物の期末残高	¥41,565	¥39,157	\$346,382



1 東京応化工業株式会社		
TOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC. (TOKアメリカ社)	TOKYO OHKA KOGYO EUROPE B.V. (TOKヨーロッパ社)	TOK Advanced Materials Co., Ltd. (TOK先端材料社)
2 本社/オレゴン工場(オレゴン州)	5 本社(オランダ)	8 本社/仁川工場(韓国)
3 販売事務所(カリフォルニア州)		
4 テキサス販売事務所(テキサス州)	TOK TAIWAN CO., LTD. (台湾東應化社)	9 シンガポール事務所
	6 本社(新竹市) 苗栗工場(苗栗市) 銅鑼工場(苗栗県)	10 上海駐在員事務所
	CHANG CHUN TOK (CHANGSHU) CO., LTD. (長春応化(常熟)社)	
	7 本社/常熟工場(中国)	

企業データ (2015年3月31日現在)

会社名 東京応化工業株式会社
 設立 1940年10月25日
 本社 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地
 従業員数 1,540名(連結)
 資本金 146億4,044万8千円
 ホームページ <http://www.tok.co.jp>
 上場取引所 東証一部
 IRお問い合わせ窓口 広報部 広報課
 川崎市中原区中丸子150番地
 TEL. 044-435-3000
 FAX. 044-435-3020

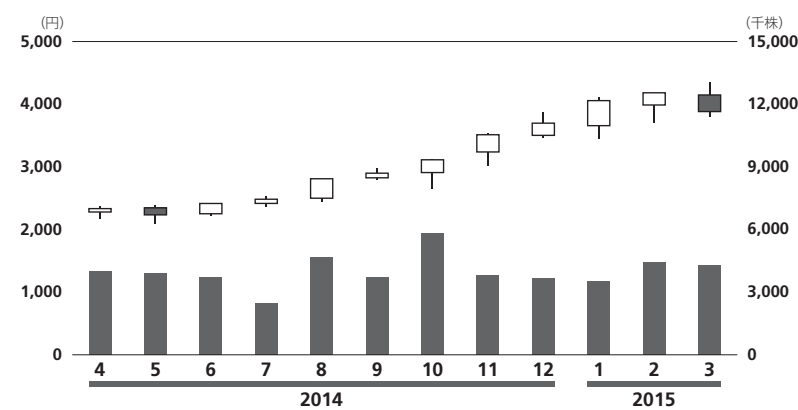


株式情報 (2015年3月31日現在)

株式の状況

発行可能株式総数 197,000,000株
 発行済株式の総数 46,600,000株
 株主数 6,257名

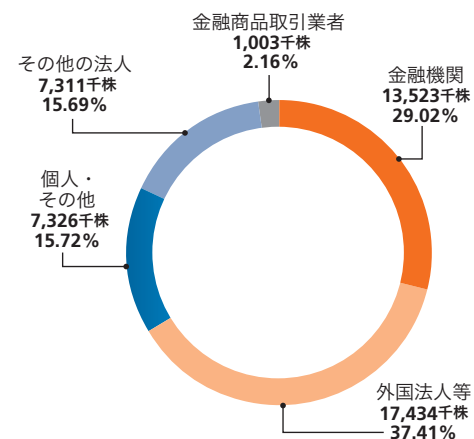
株価・出来高の推移



大株主(上位10名)

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	2,029	4.51
明治安田生命保険相互会社	1,826	4.06
MLPFS CUSTODY ACCOUNT	1,494	3.32
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,402	3.12
CBNY-EDGEPOINT GLOBAL PORTFOLIO	1,267	2.82
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,207	2.68
株式会社横浜銀行	1,026	2.28
公益財団法人東京応化科学技術振興財団	984	2.19
三菱UFJ信託銀行株式会社	953	2.12
MSIP CLIENT SECURITIES	915	2.03

所有者別株式分布状況



注)1. 当社は、自己株式を1,598千株保有しておりますが、上記大株主から除いております。
 2. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を除いた株式数(45,001,674株)を基準に算出しております。

日本語版アニュアルレポートの位置づけにつきまして

日本語版アニュアルレポートにつきましては、英語版との相違が生じないように配慮して作成しており、日本語版に掲載している連結財務諸表は、英文財務諸表の和訳となっております。また連結財務諸表および財務注記の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載している別冊PDFをご参照ください。

<http://www.tok.co.jp/ir/library/annual>